

# DOUTNAVÝ VÝBOJ

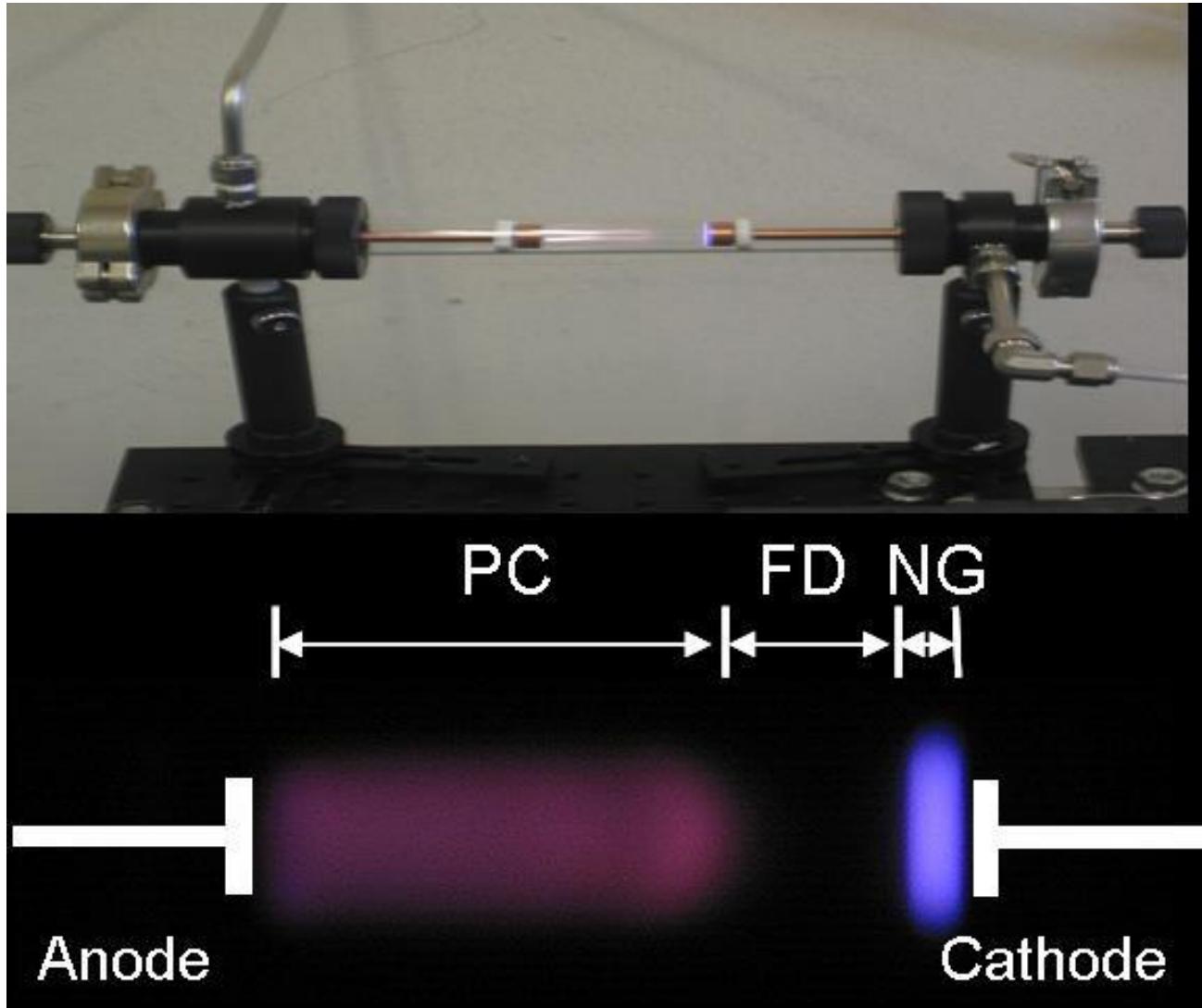
F3180 | Výboje v plynech

prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

M U N I  
S C I

# Doutnavý výboj

**Doutnavý (tlecí výboj)** – horí pri zníženom tlaku, obvykle menej než 0,01 atm

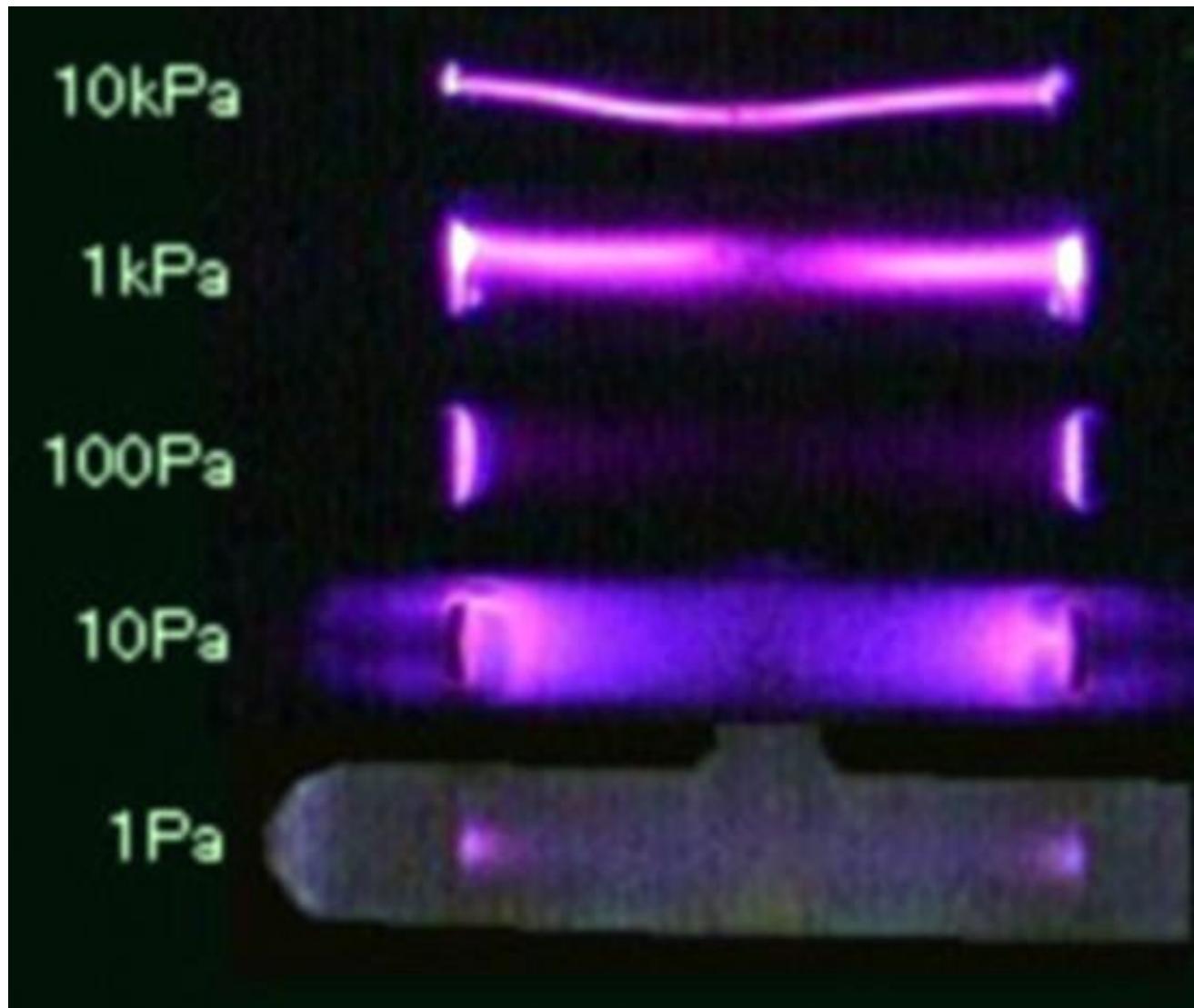


Doutnavý  
výboj  
ve vzduchu

# Doutnavý výboj

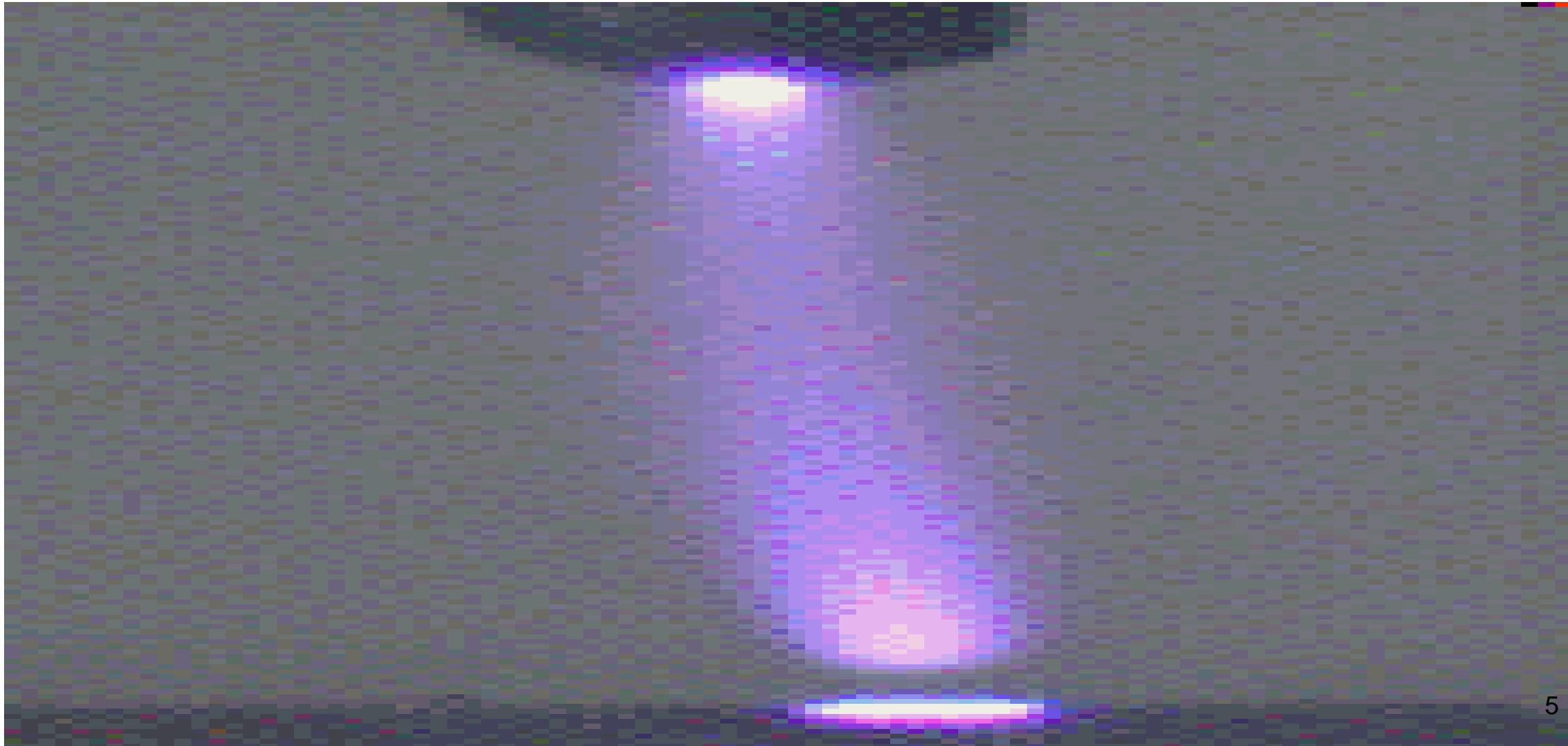
$(j/p^2) = \text{konst.}$

(Engel a Steinbeck)



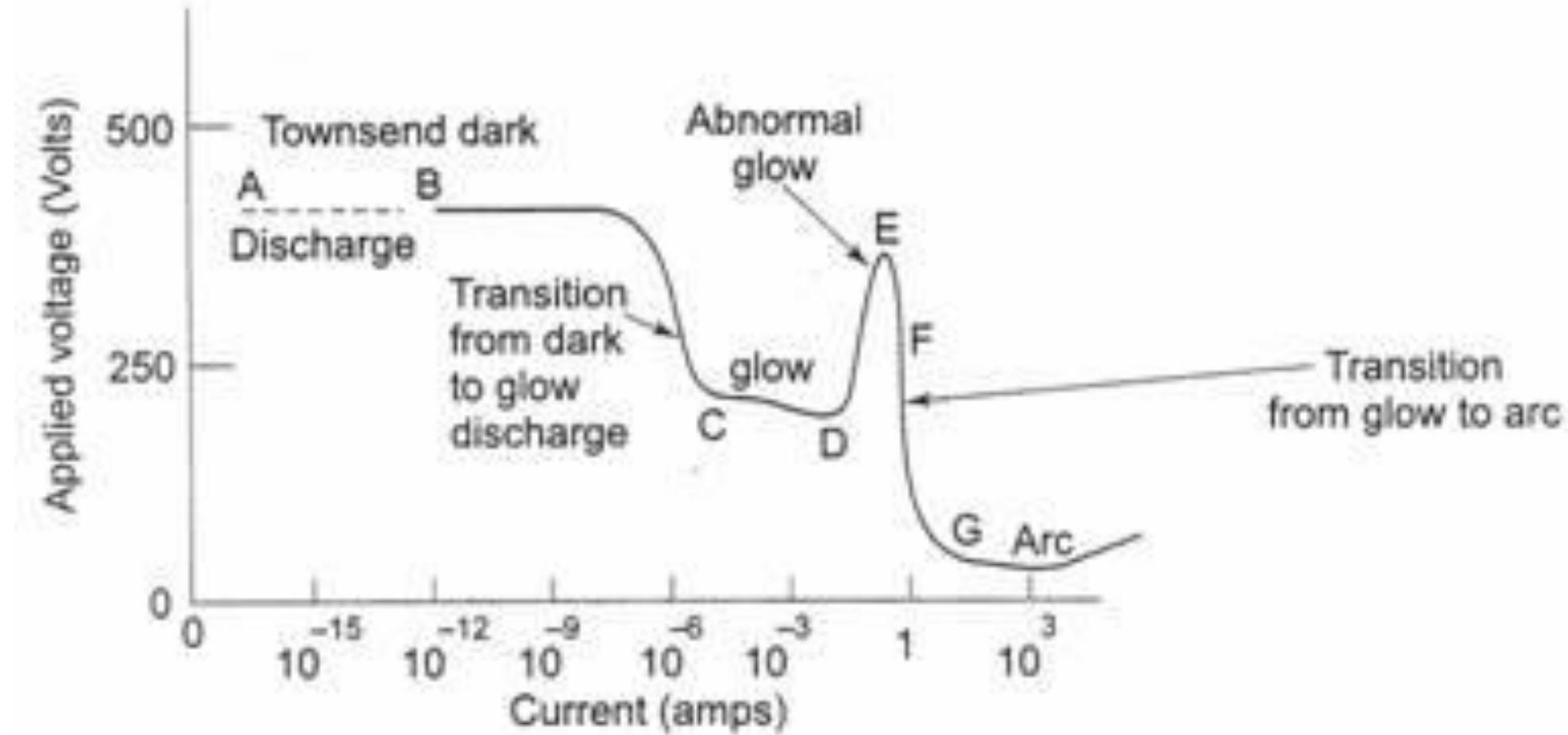
# Doutnavý výboj

Doutnavý výboj môže v zvláštnych prípadoch horieť i za atmosferického tlaku:



# Zapálenie samostatného výboja

MUNI  
SCI



# Doutnavý výboj

## Oblasti tlecieho/doutnavého výboja:

**Katódová vrstva** (katódový potenciálový spád – najdôležitejšia pre existenciu výboja):

**Astonov tmavý priestor** – elektróny sa urýchľujú, ešte nemajú energiu dostatočnú na excitáciu

**Kátodové svetlo** – elektróny už excitujú, ale ešte neionizujú

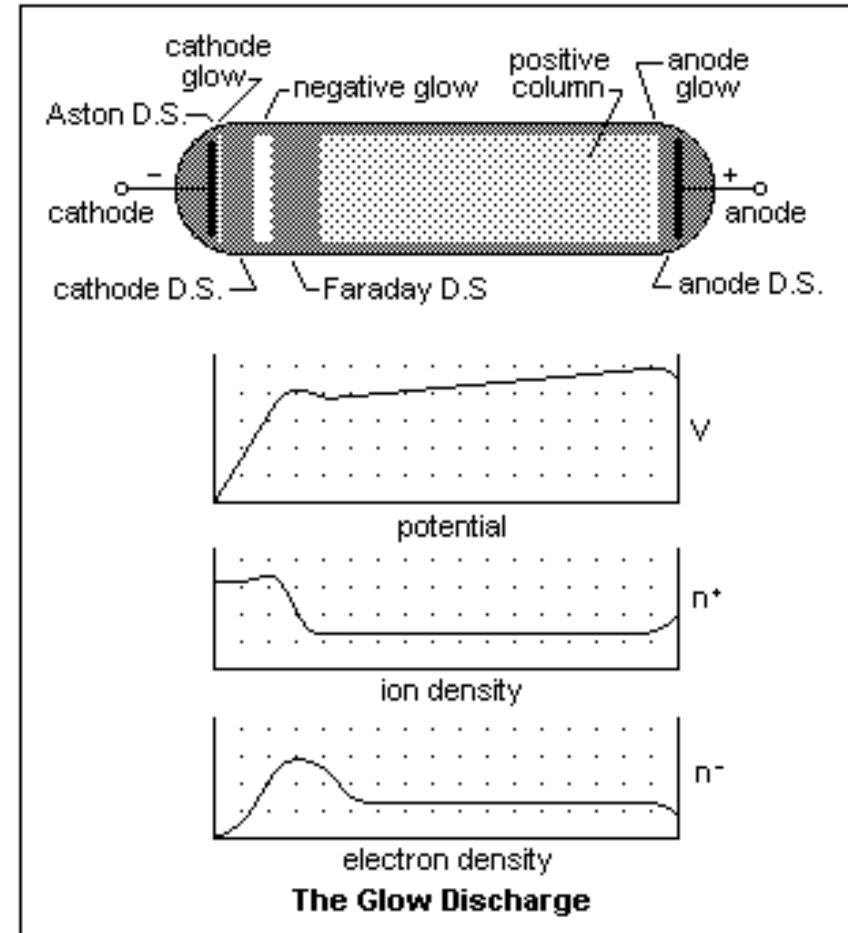
**Katódový tmavý priestor** – už neexcitujú ale ešte neionizujú

**Záporné svetlo** – ionizujú (tu vzniká väčšina elektrónov)

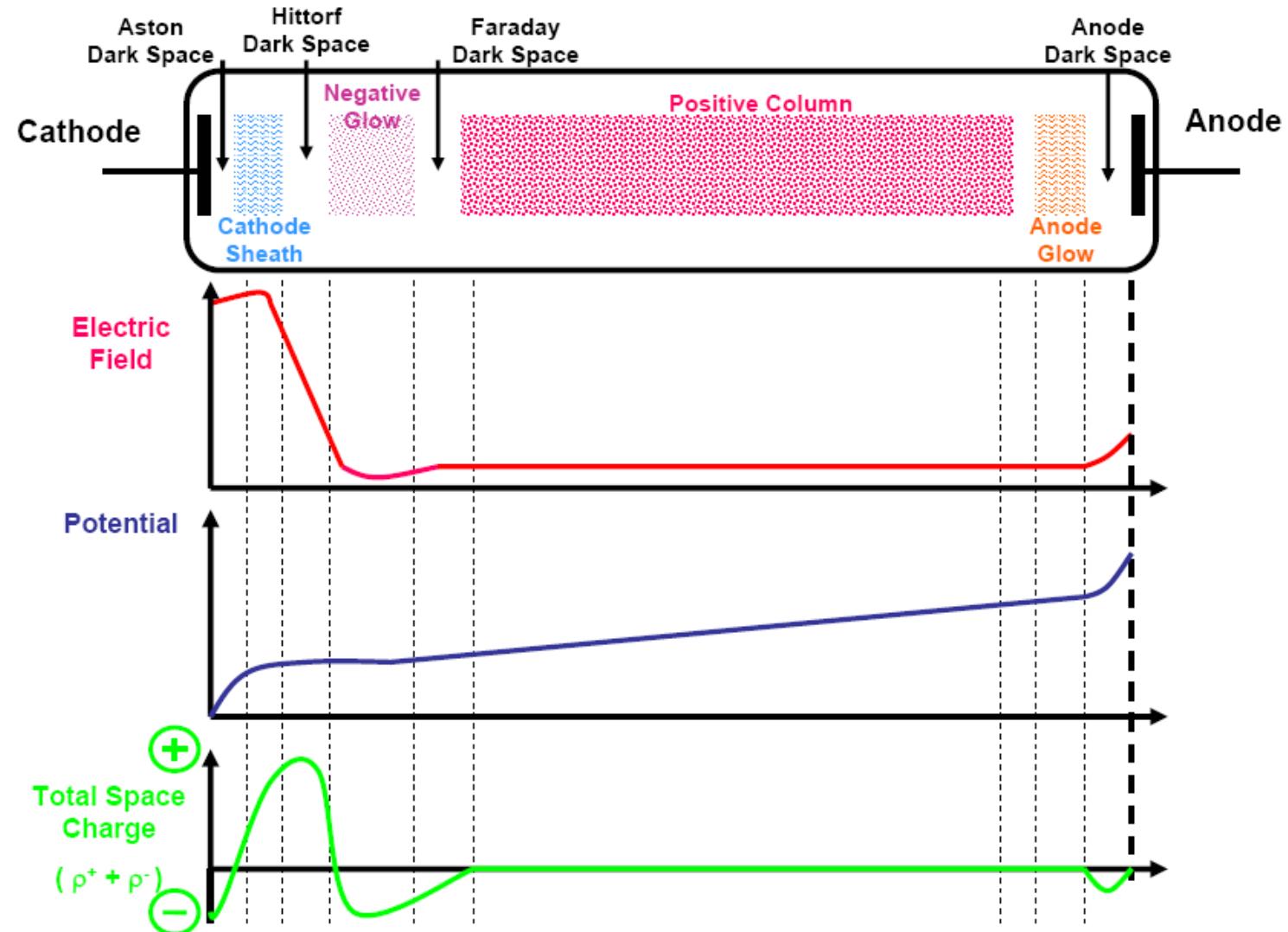
**Faradayov tmavý priestor** – majú malú energiu, takže ani neexcitujú

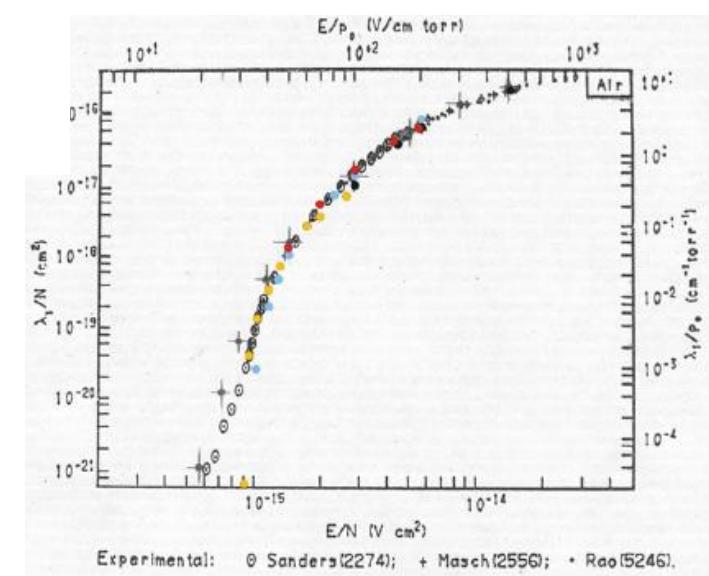
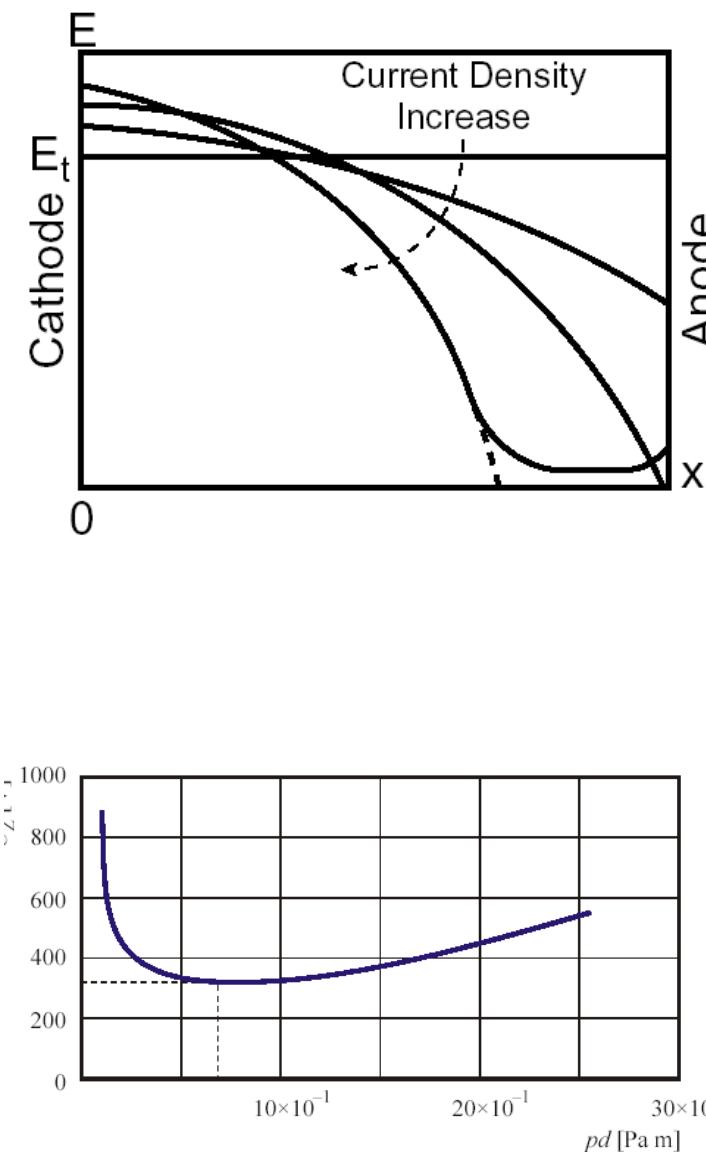
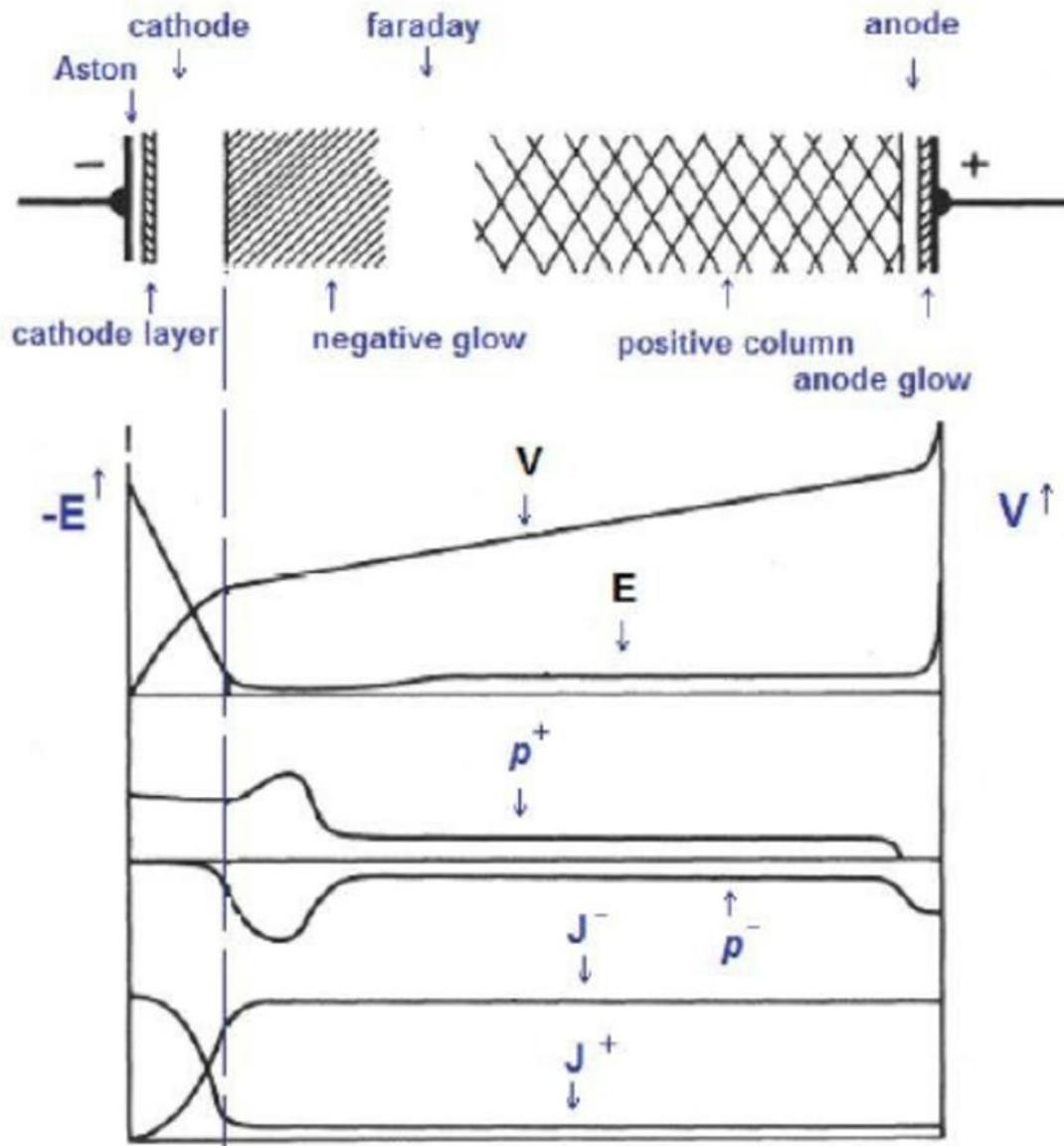
**Kladný stípec** – nie je dôležitý pre existenciu výboja, ale významný pre aplikácie – kvázineutrálna izotermická plazma

**Anódové svetlo**



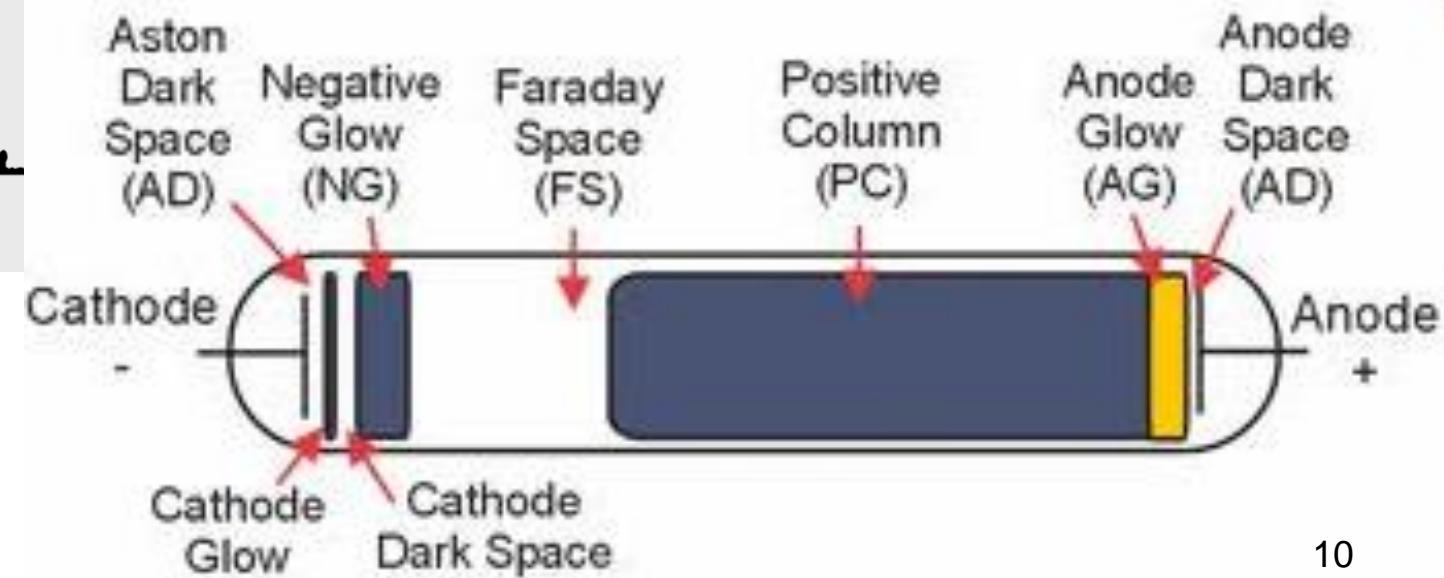
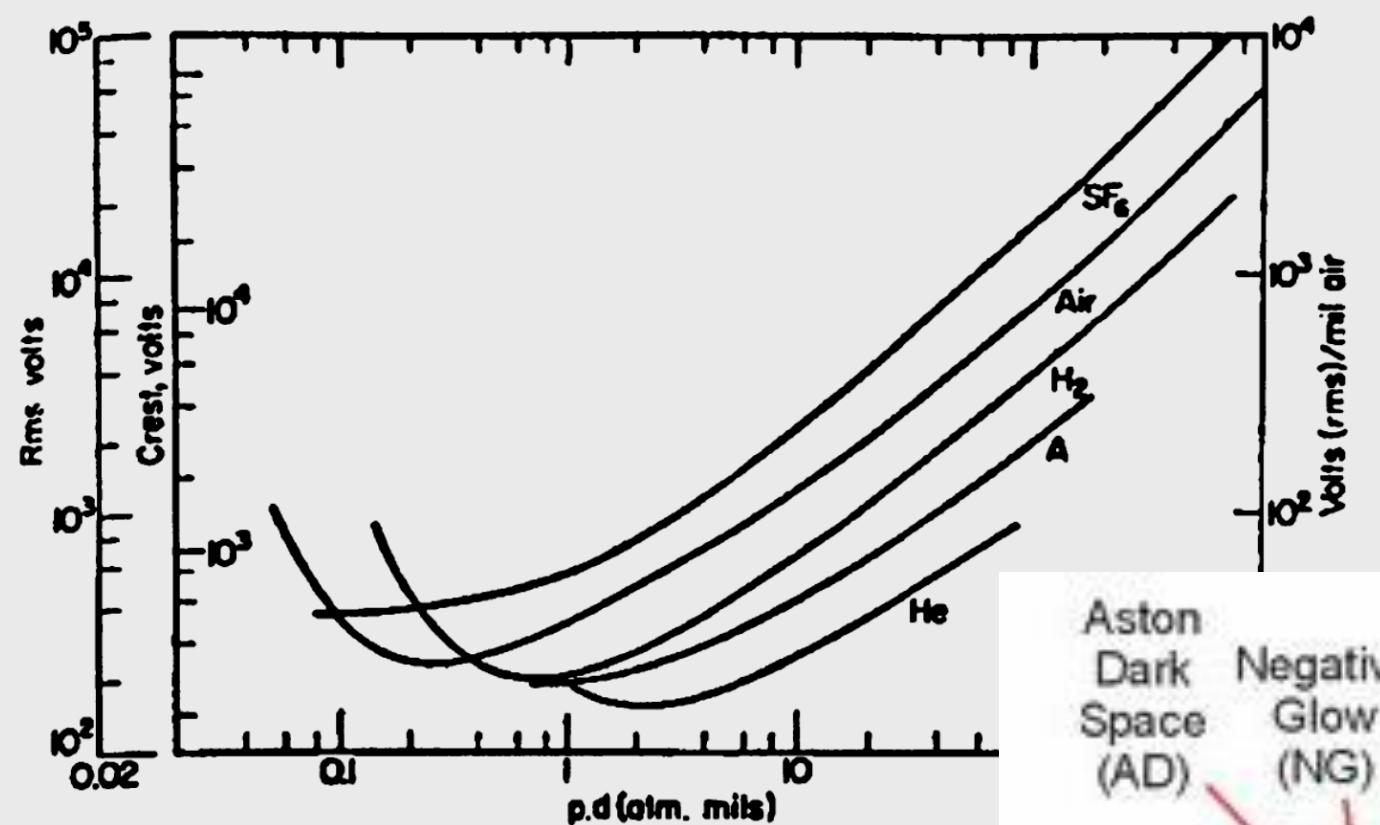
# Doutnavý výboj



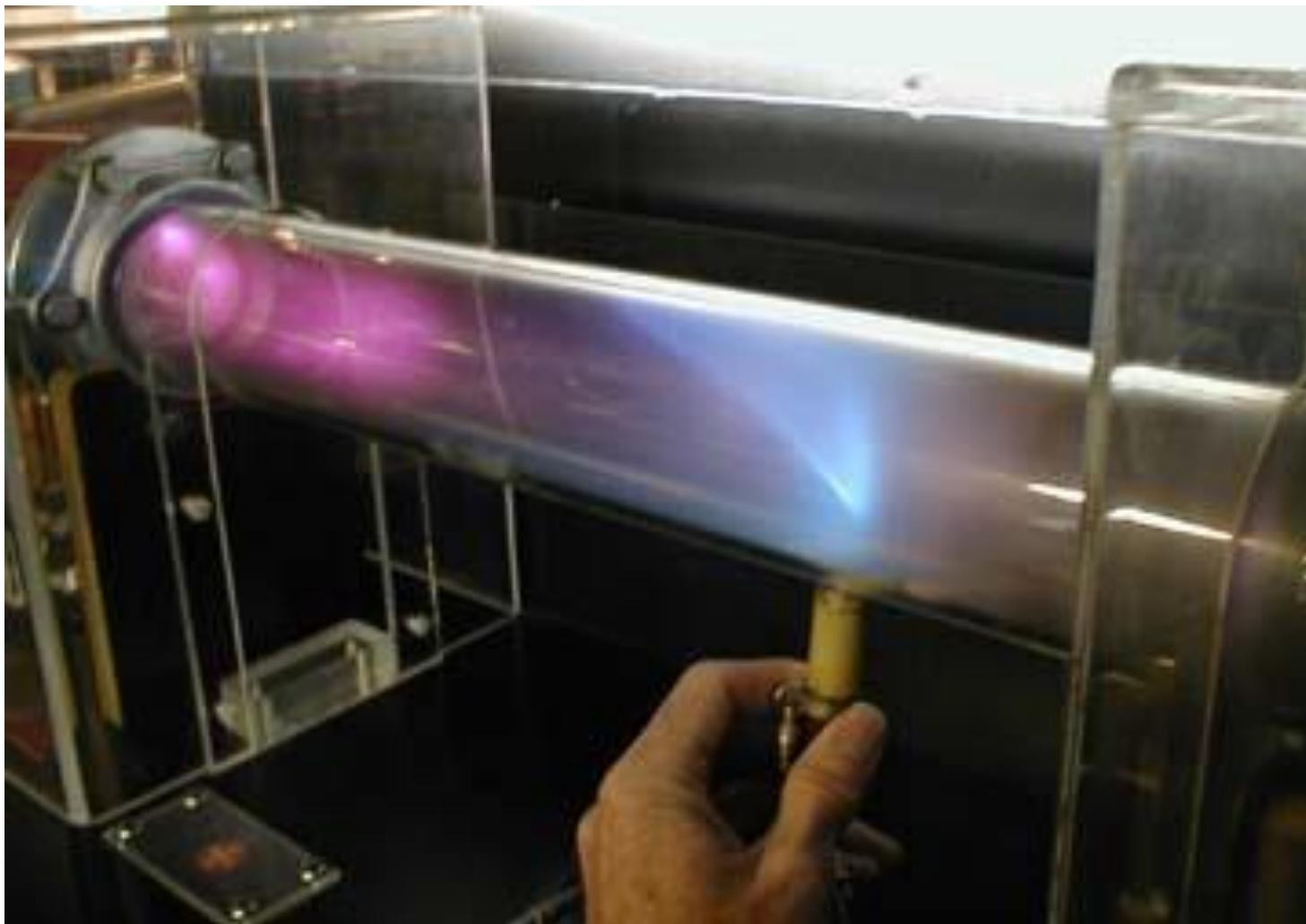


# Paschenova krivka – šírka katódovej oblasti:

MUNI  
SCI



Pri nízkom tlaku a vysokom napäti možno pozorovať vytvorenie elektrónového lúča:



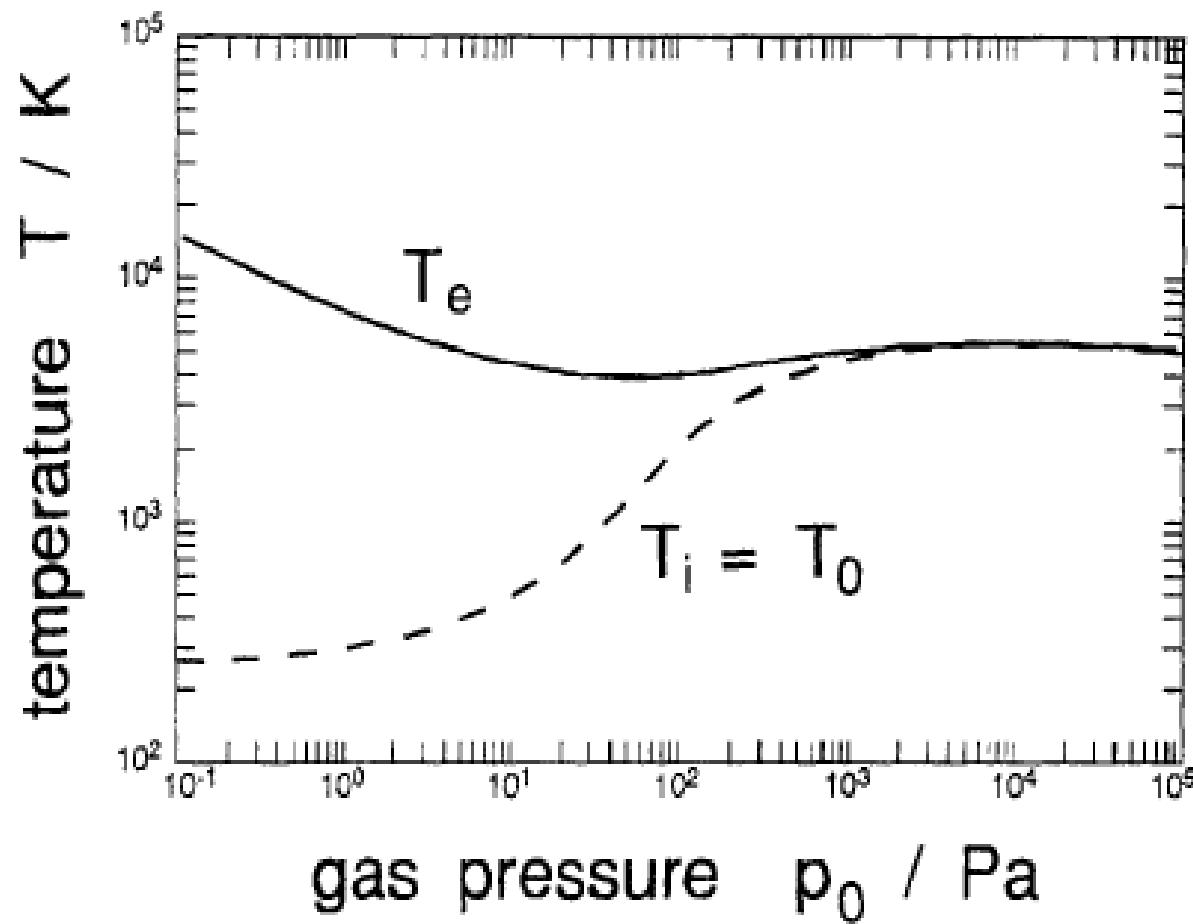
# Elektrická plazma - definícia:

MUNI  
SCI

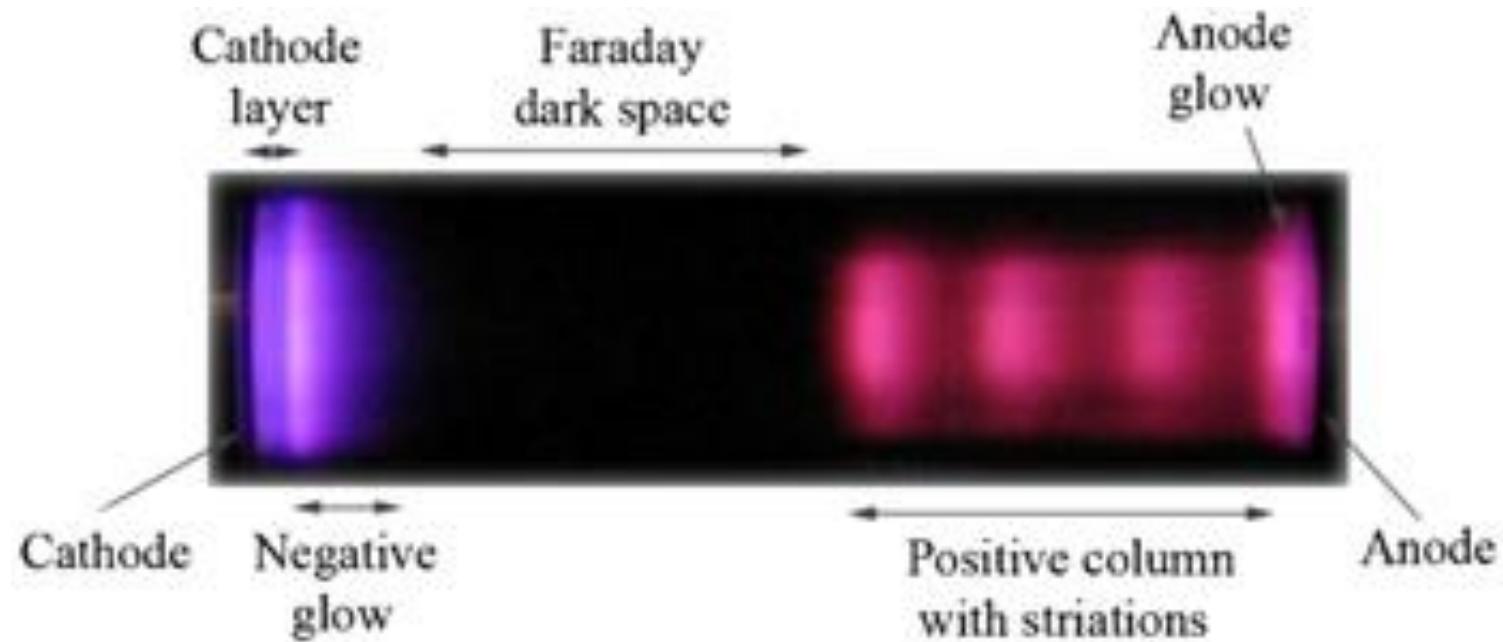
- Podmienka kvázineutrality
- Debyeov polomer tienenia je menší než charakteristický rozmer plazmy – plazma čiastočne tieni vonkajšie elektrické pole – na vonkajšiu zmenu poľa reaguje prerozdelením alebo vytvorením nového náboja

# Plazma kladného stípca tlecieho výboja

**Plazma kladného stípca tlecieho výboja – neizotermická plazma**



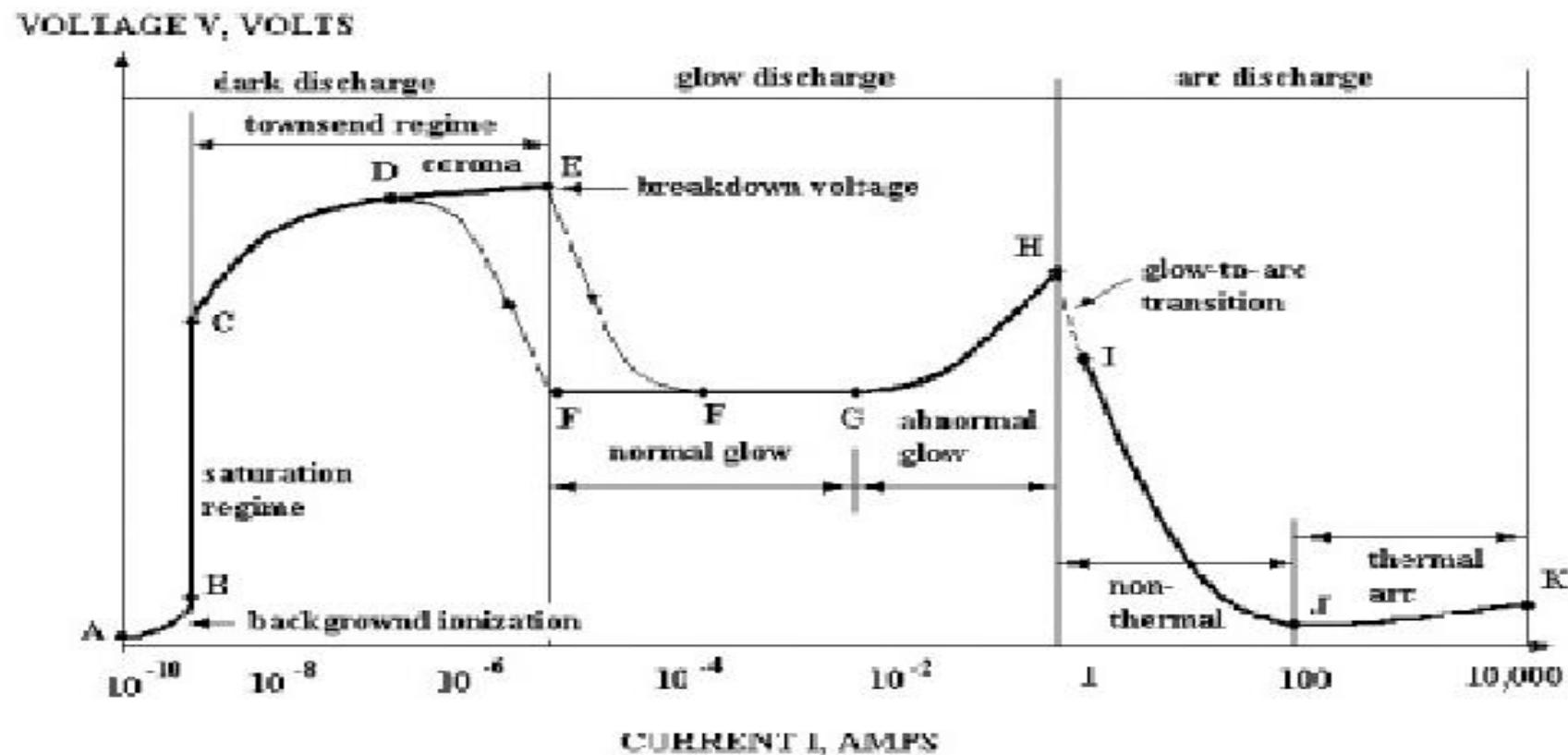
**Striacie** sú vrstvy viditeľné v plazme tlecieho výboja: pomocou rýchlych kamier. Niekedy, keď sa nepohybujú sú viditeľné i voľným okom



Ako vysvetlili Franc and Herz už v r. 1914 hlavným dôvodom je, že elektróny v plazme odovzdávajú svoju energiu po kvantoch a takto excitované molekuly/atómy ju zase v kvantoch vyžarujú. Tento jav však veľmi zložitejší a súvisí so šírením ionizačných vĺn v plazme kladného stĺpca. Doteraz nie je uspokojivo kvantitatívne opísaný.

**Normálny tlecí výboj** – udržiava si konštantný katódový spád odpovedajúci minimu Paschenovej krivky a konštantnú hustotu prúdu výboja  $j/p^2 = \text{konst.}$

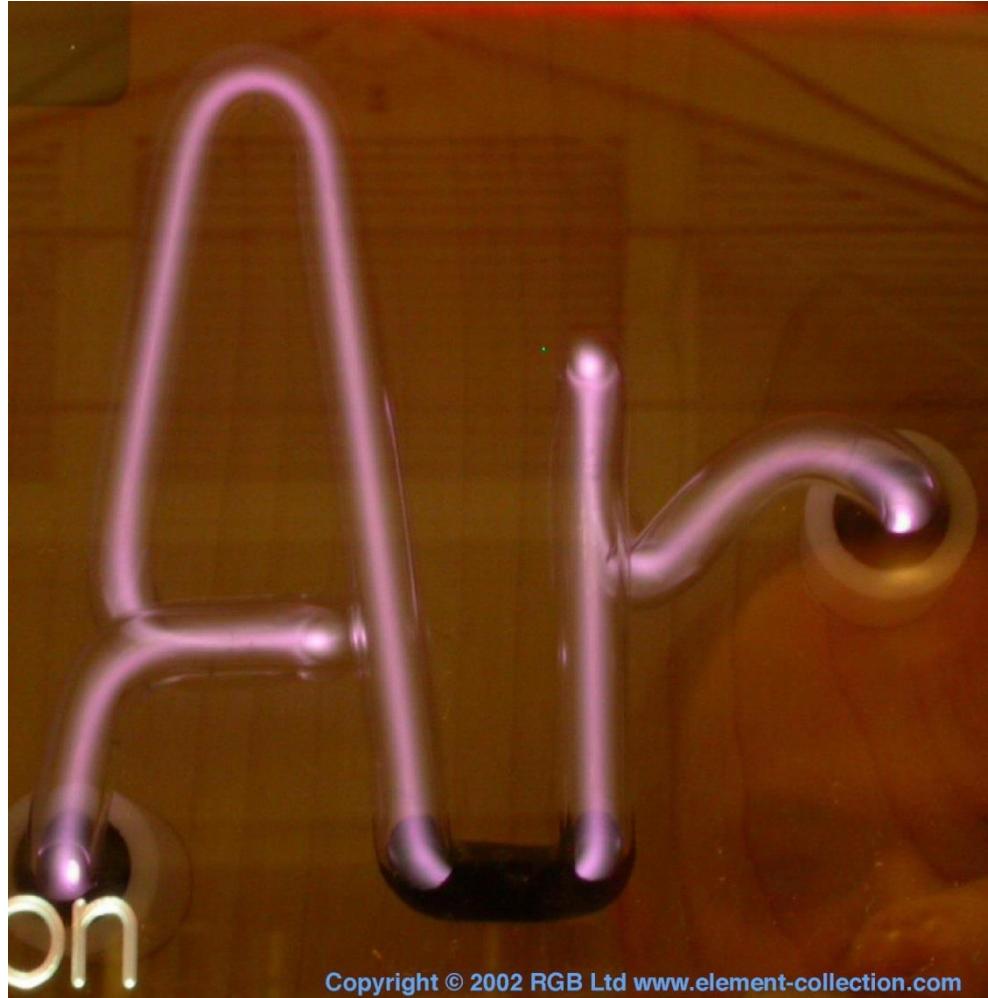
**Anomálny tlecí výboja** – má vyššiu hustotu prúdu a vyšší katódový spád



Aplikácie neizotermickej plazmy kladného stĺpca tlecieho výboja:

MUNI  
SCI

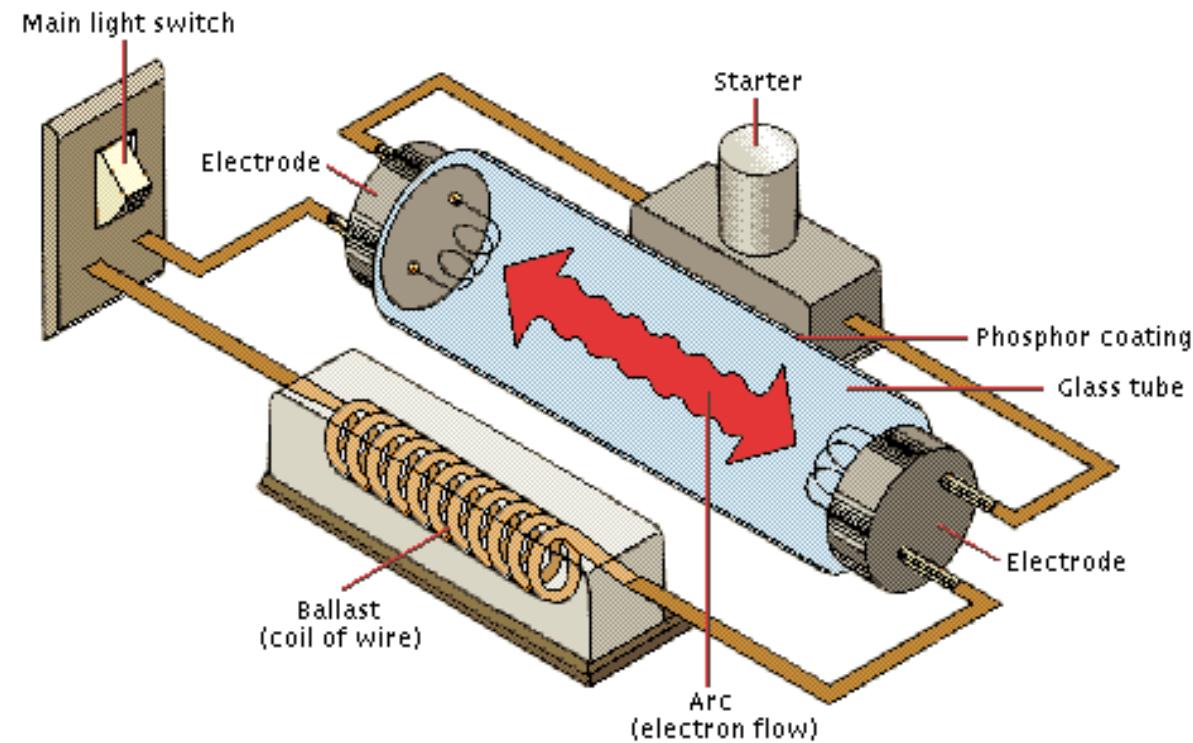
„neónky“

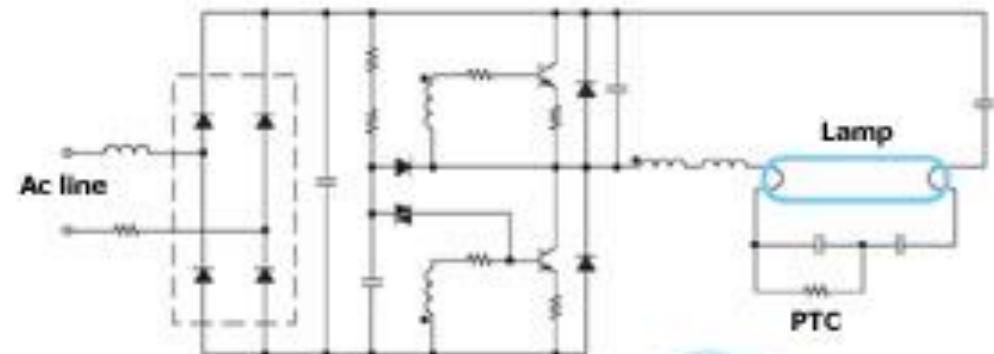
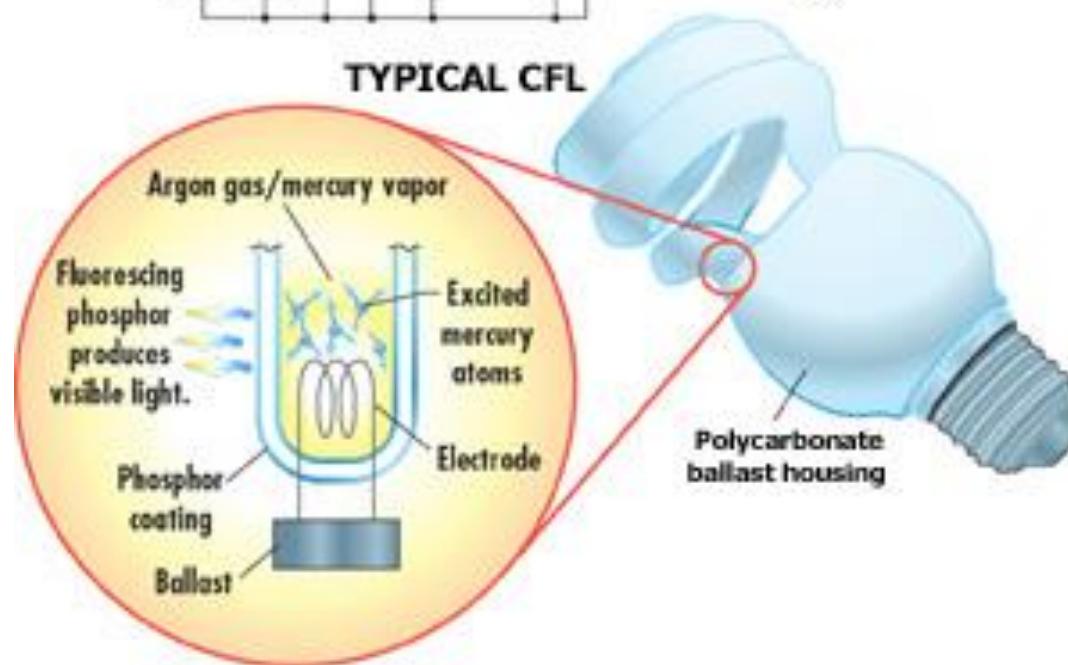


Copyright © 2002 RGB Ltd [www.element-collection.com](http://www.element-collection.com)

## Žiarivky (fluorescenčné zdroje svetla založené na tlecom výboji)

Žiarivka pozostáva zo sklenej trubice pokrytej fluorescenčnou vrstvou, štartéra a balastnej záťaže. El. prúdom, ktorý dodá štartér sa napred rozhaví vlákno vo vnútri trubice, ktoré potom termoemisiou emituje elektróny štartujúce tlecí výboj v trubici. Trubica je naplnená obyčajne argónom s malou prímesou pár ortute, ktorá vyžaruje hlavne v ultrafialovej oblasti spektra. Fluorescenčná vrstva mení ultrafialové žiarenie na viditeľne. Balastná záťaž stabilizuje výboj, čiže zabraňuje vzniku oblúkového výboja.



**Industry-standard solid-state ballast circuit for CFLs****TYPICAL CFL**

Jednotlivé materiály v žiarivke:

- Argón – slúži na ľahké zapálenie a udržanie výboja
- Ortut' – po ohriatí sa jej pary excitujú a vyžarujú s vysokou účinnosťou UV žiarenie
- Fluorescenčná vrstva – mení UV žiarenie na viditeľné so spektrom blízkym slnečnému žiareniu

- Bez fluorescenčnej vrstvy:

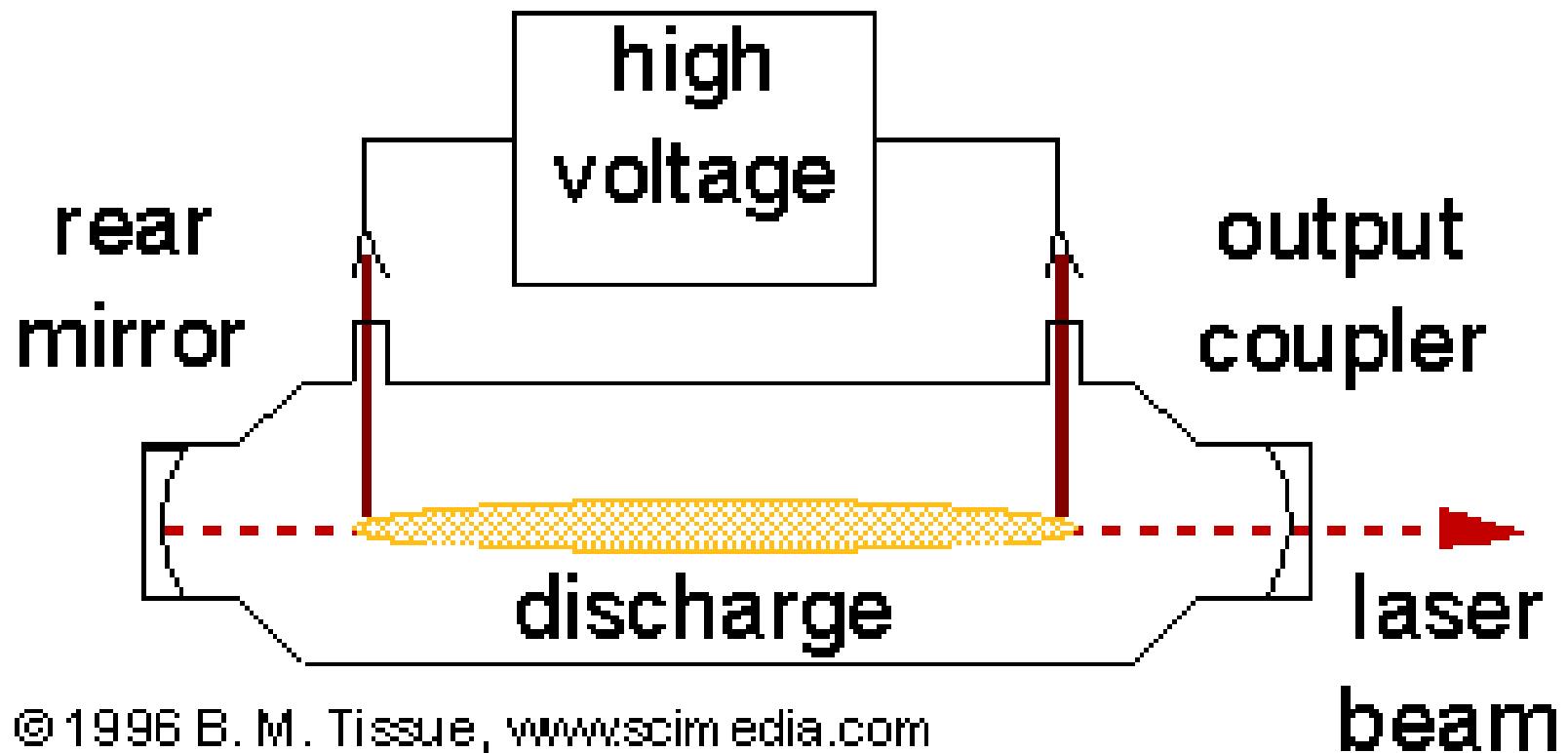


# Plynové lasery

- A laser is a coherent and highly directional radiation source. LASER stands for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
- A laser consists of at least three components:
- a gain medium that can amplify light that passes through it
- an energy pump source to create a population inversion in the gain medium
- two mirrors that form a resonator cavity
- The gain medium can be solid, liquid, or gas and the pump source can be an electrical discharge, a flashlamp, or another laser. The specific components of a laser vary depending on the gain medium and whether the laser is operated continuously (cw) or pulsed. The following headings describe specific laser designs.

# Plynové lasery

**Plynové lasery sú obvykle budené el. výbojmi v plyne.**



© 1996 B. M. Tissue, [www.scimmedia.com](http://www.scimmedia.com)

# Plynové lasery

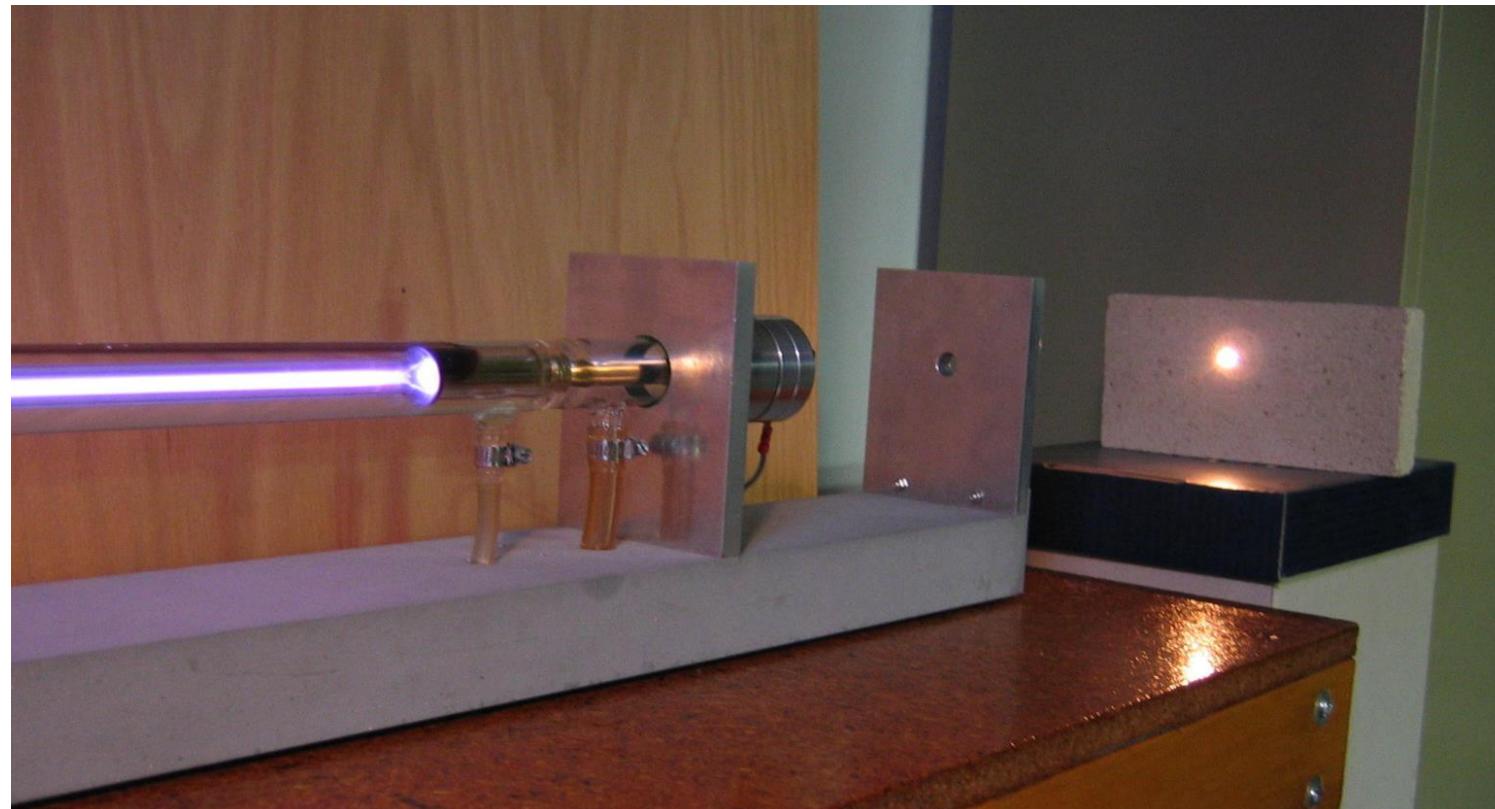
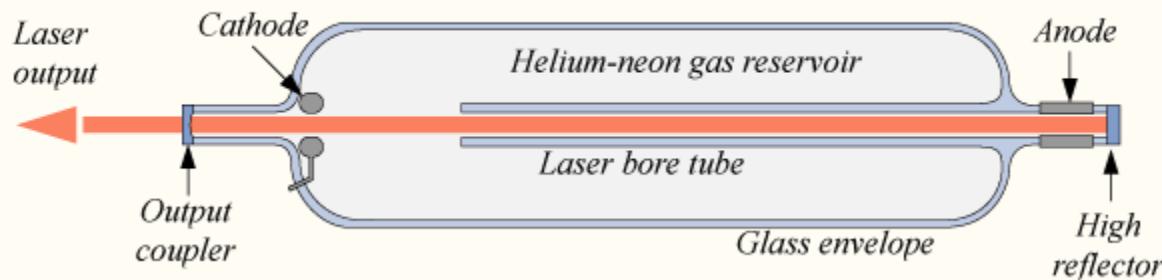
**Excimer : ArF\* - 248 nm, XeCl\* - 308 nm (pulsed)**

**nitrogen : 337 nm (pulsed)**

**He-Ne : 632.8 nm (cw)**

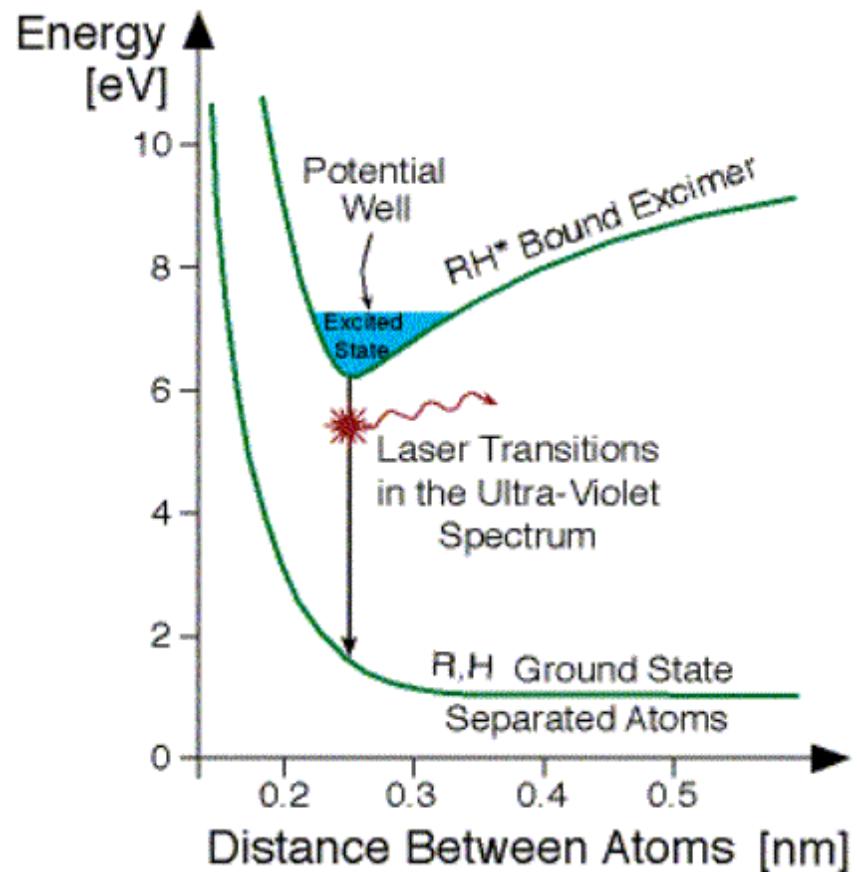
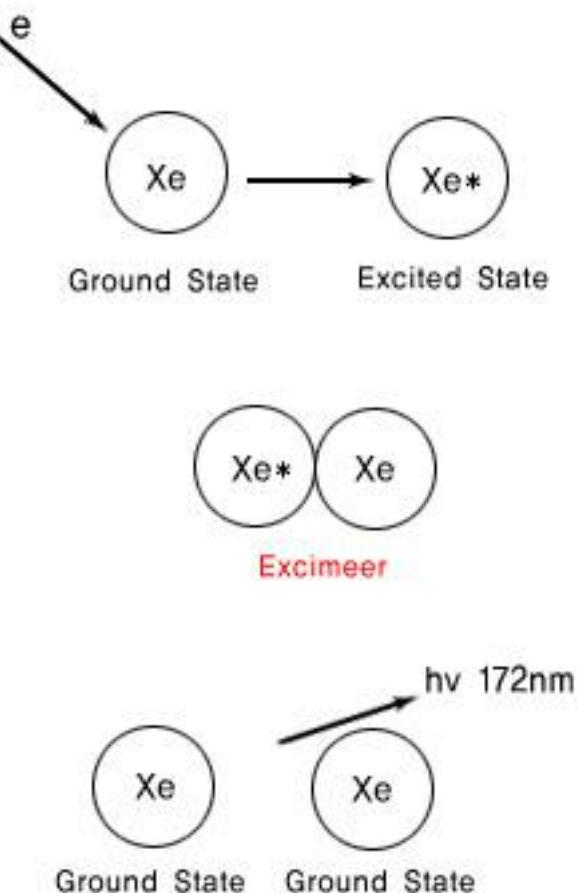
**Ar ion : 488, 541 nm (cw)**

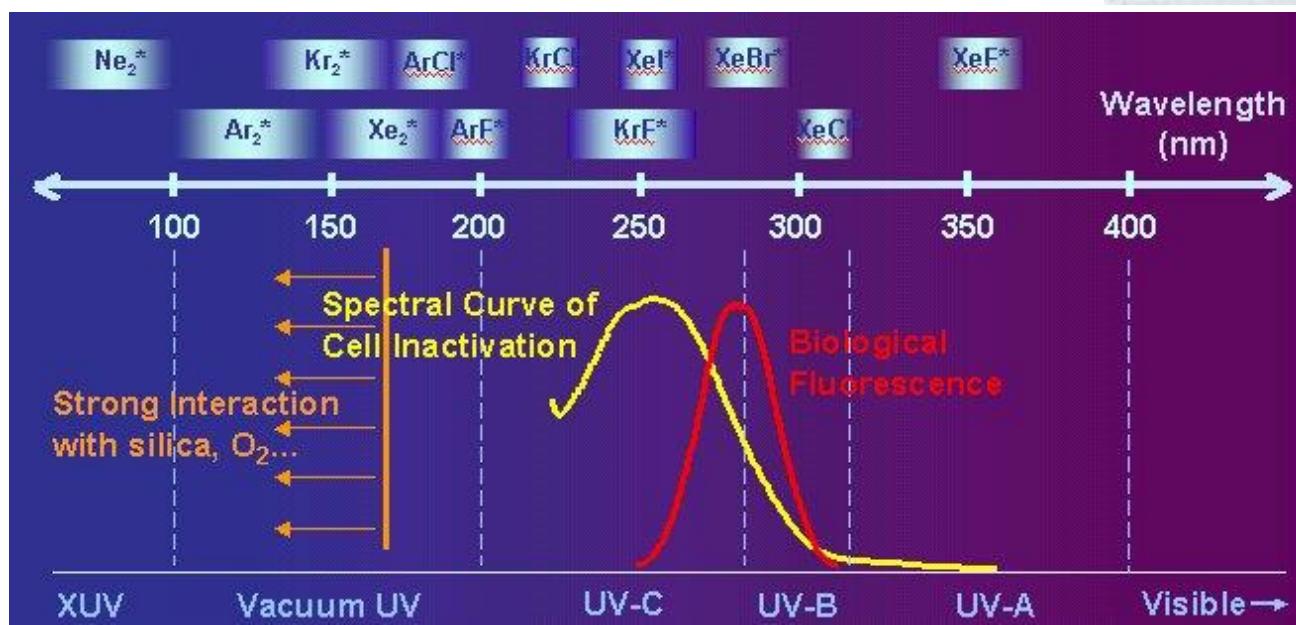
**CO<sub>2</sub> : 10.6 μm (cw or pulsed)**

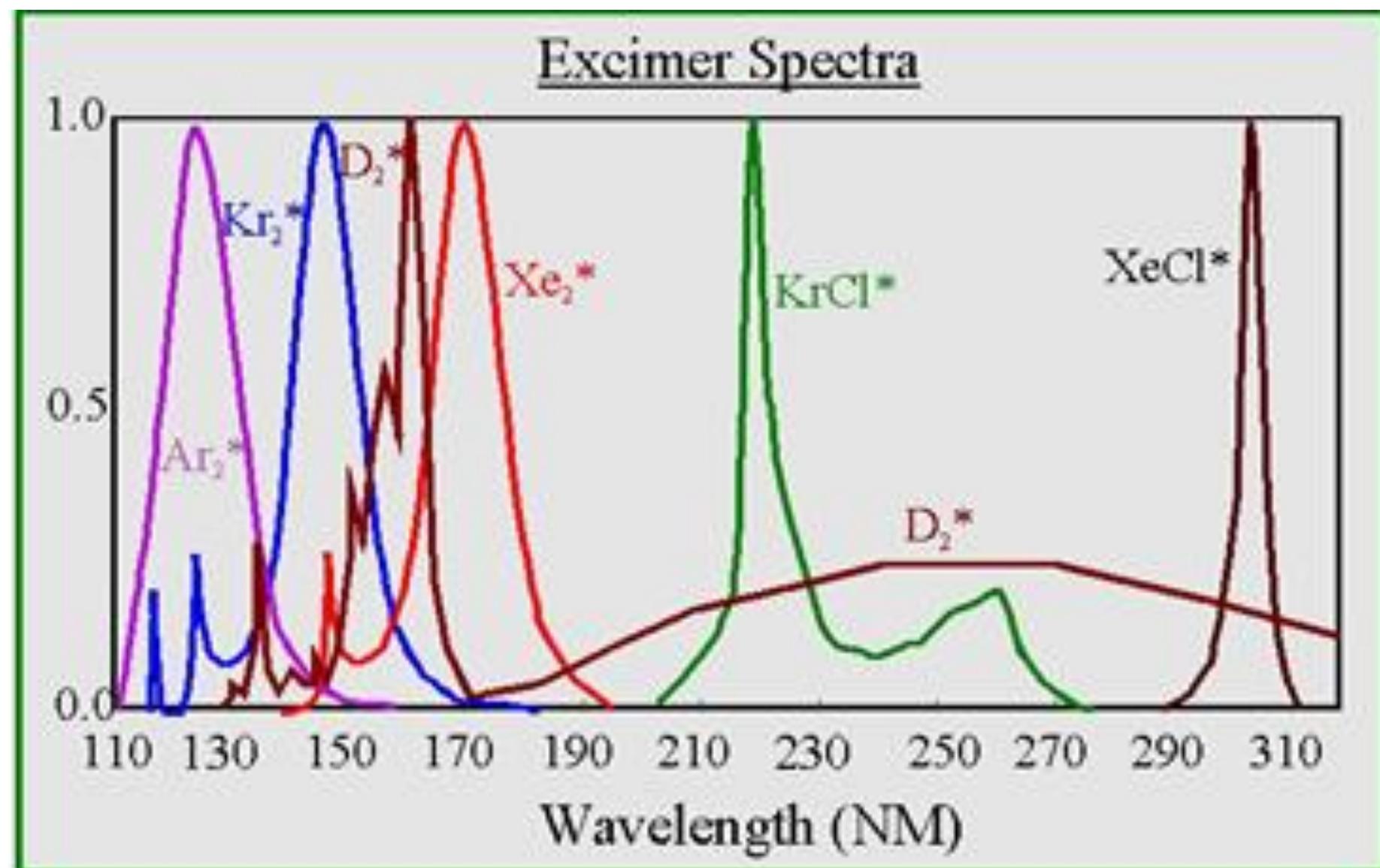


# Plynové lasery

**Excimérne lasery a lampy – účinnosť až 40% !**



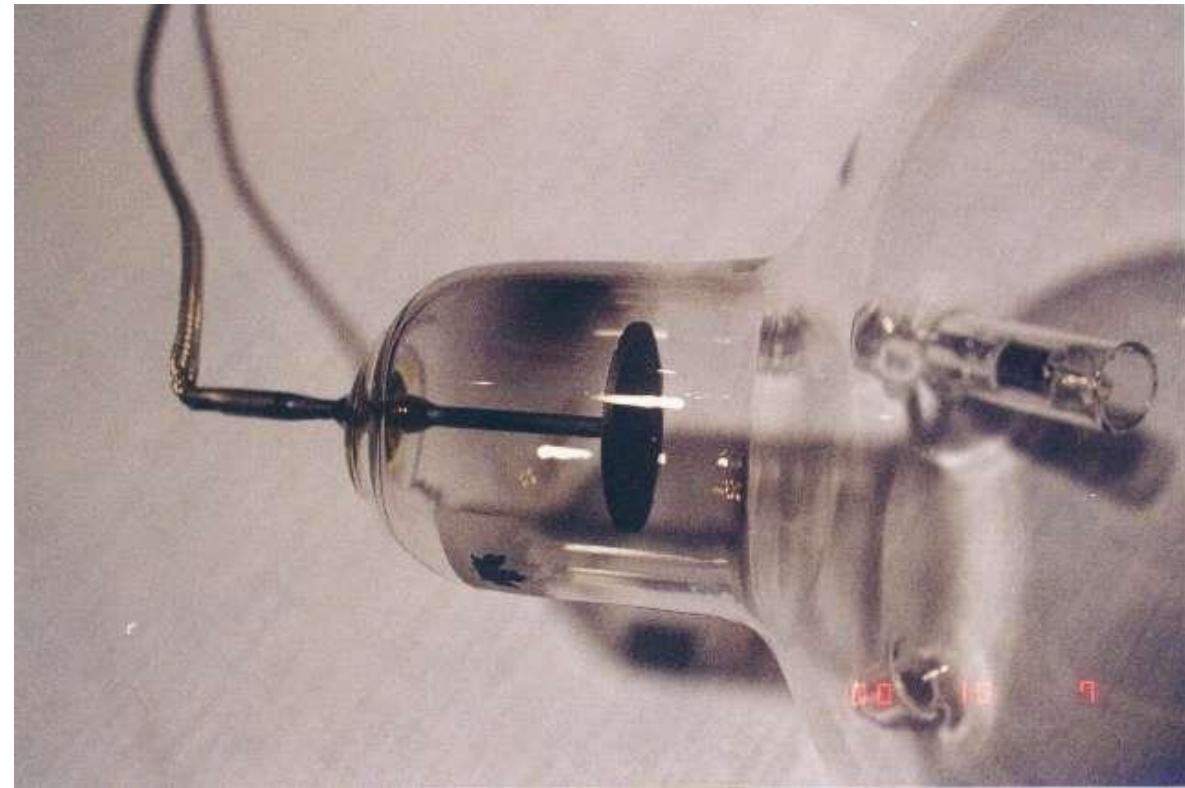
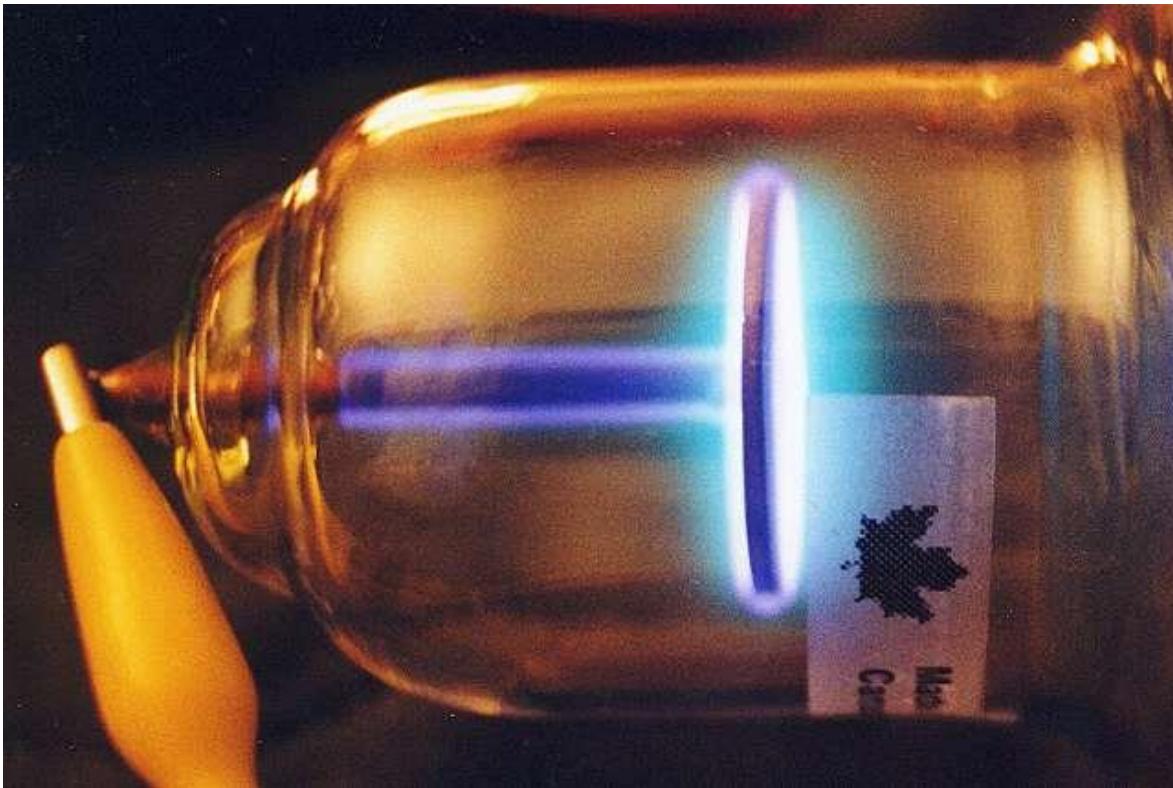


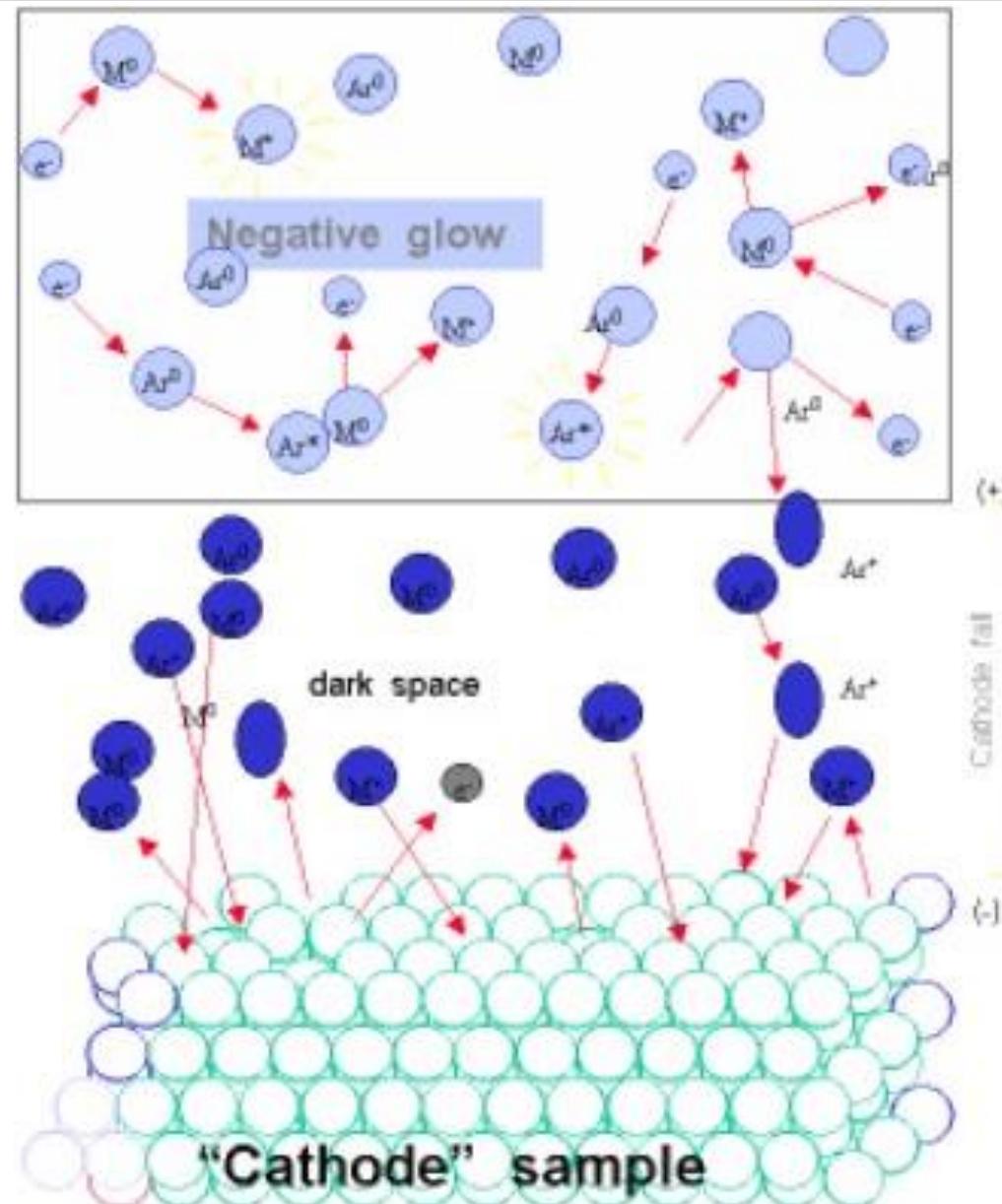


# Aplikácie javov na katóde tlecieho výboja

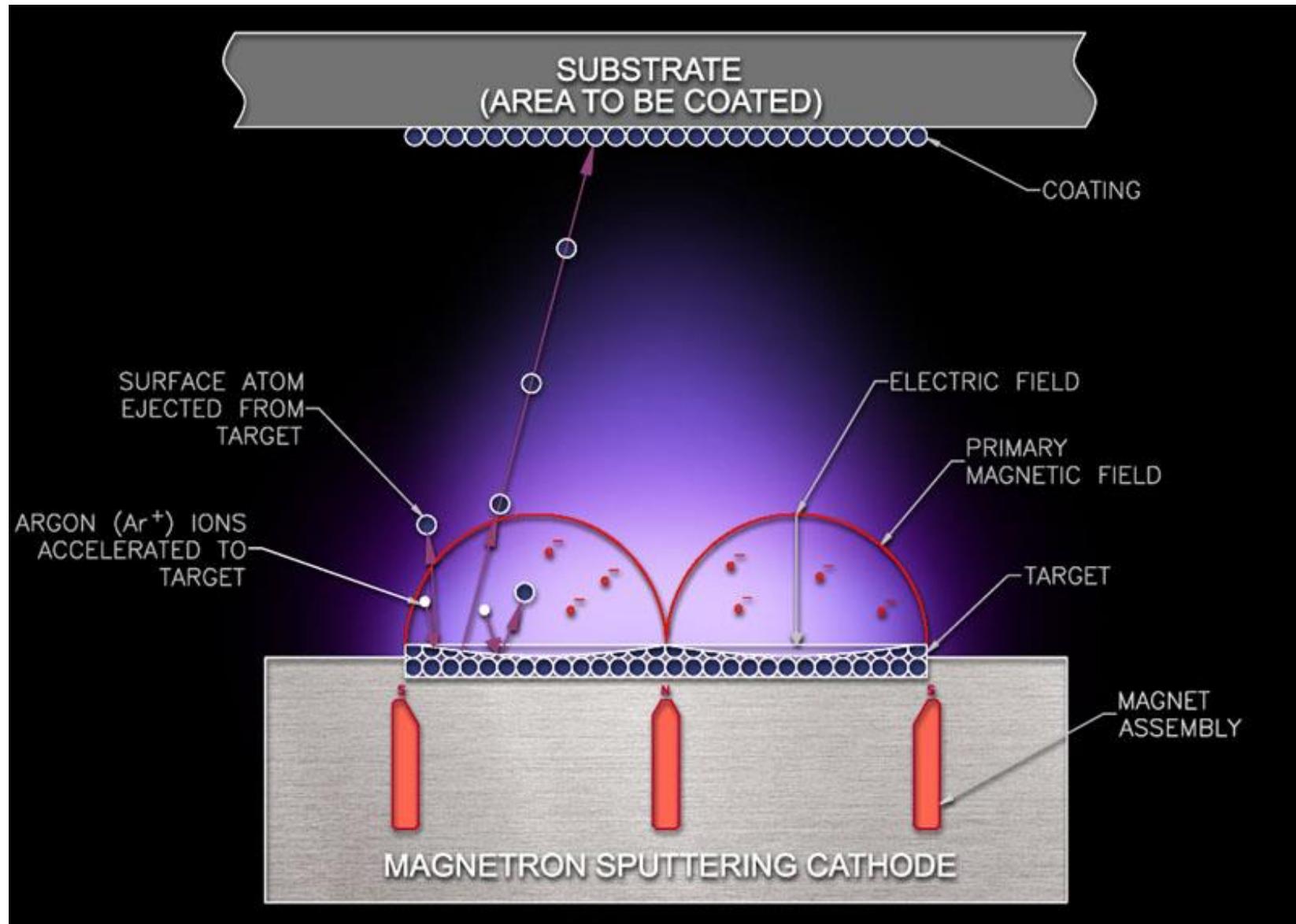
MUNI  
SCI

## - katódové rozprašovanie

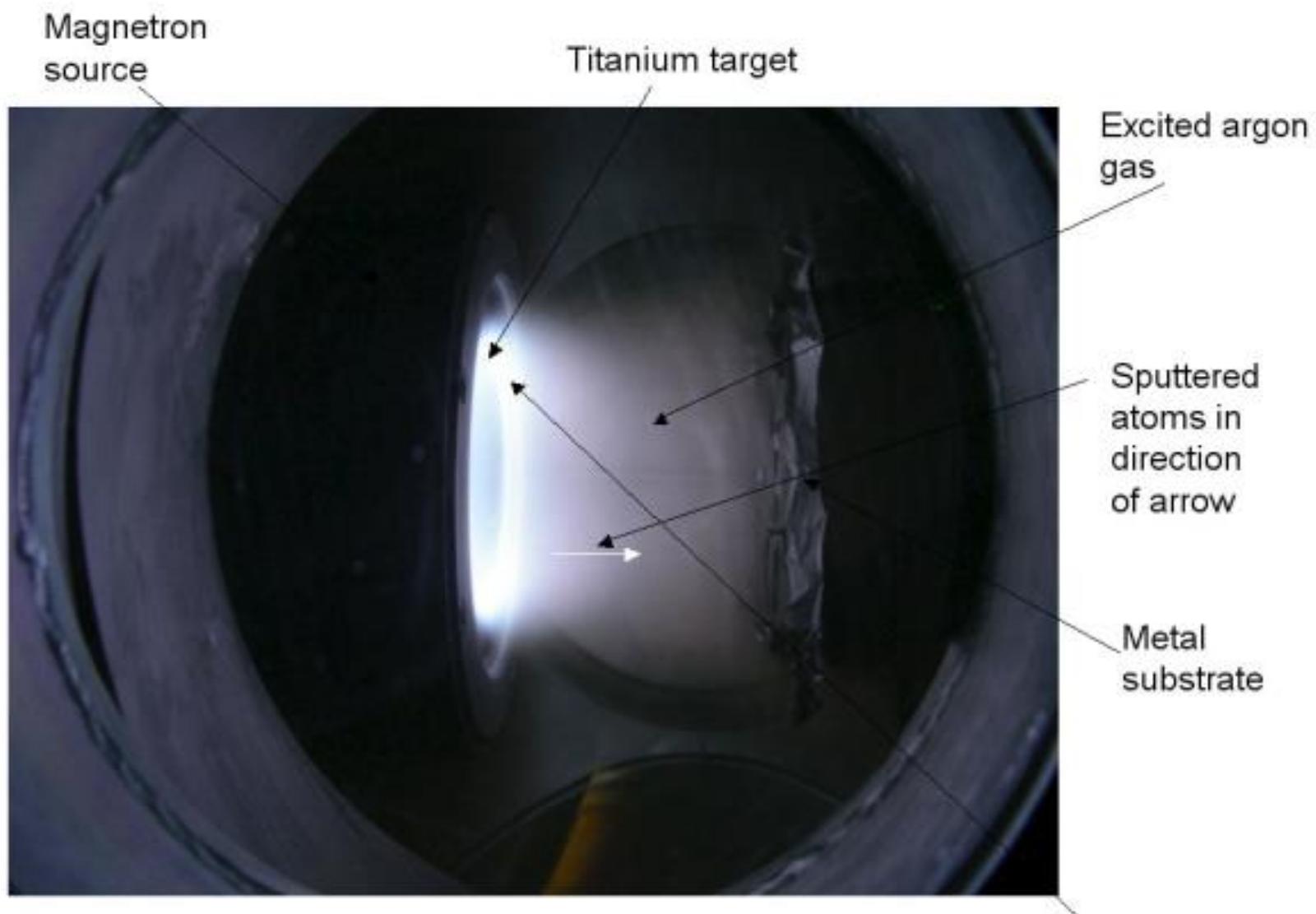




# Magnetrón



# Magnetron



Bright plasma ring – electrons trapped in the magnetic field which emanates from a set magnets behind the target

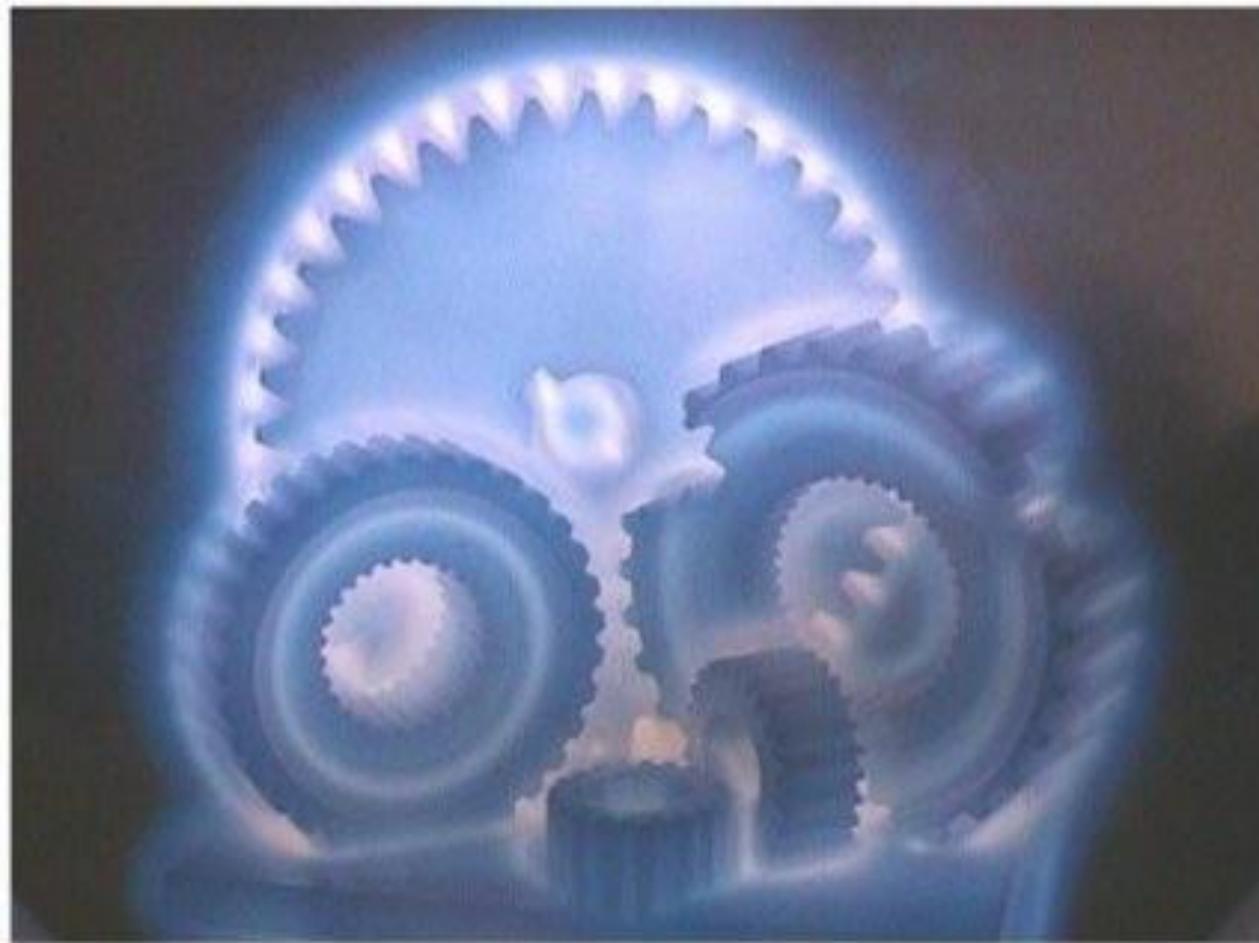
# Magnetrón

## Terčíky

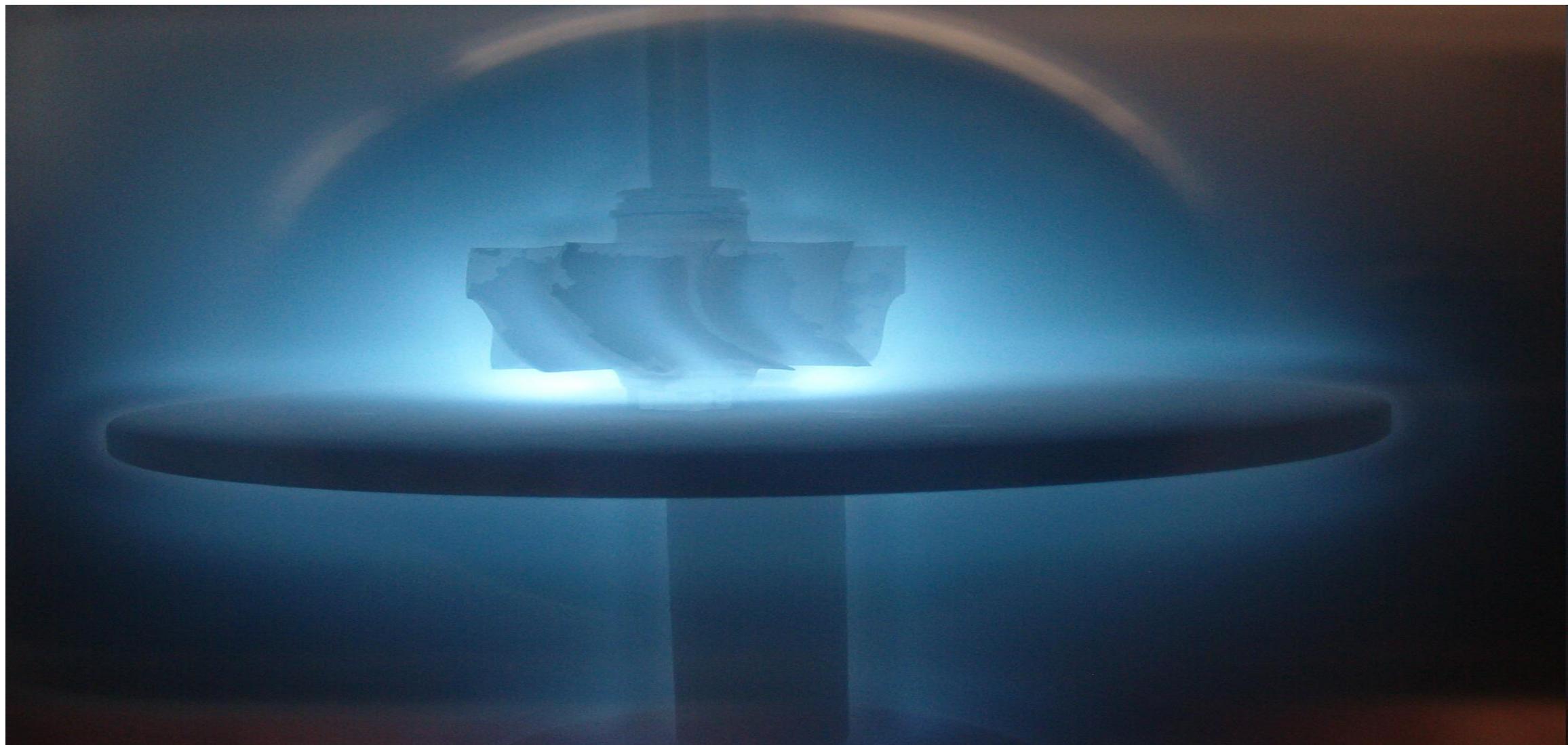


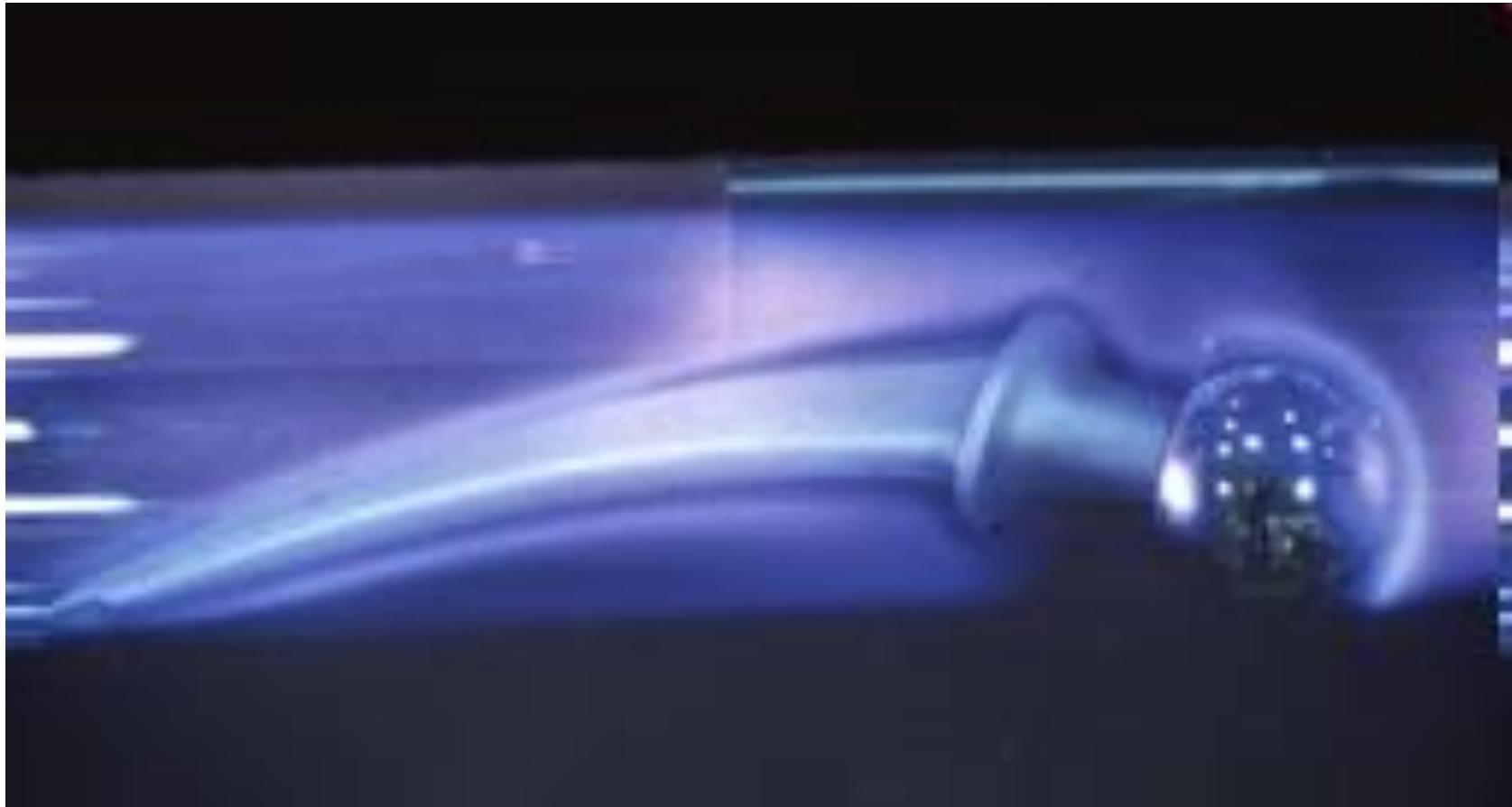
# Plazmová nitridácia

MUNI  
SCI



# Plazmová nitridácia

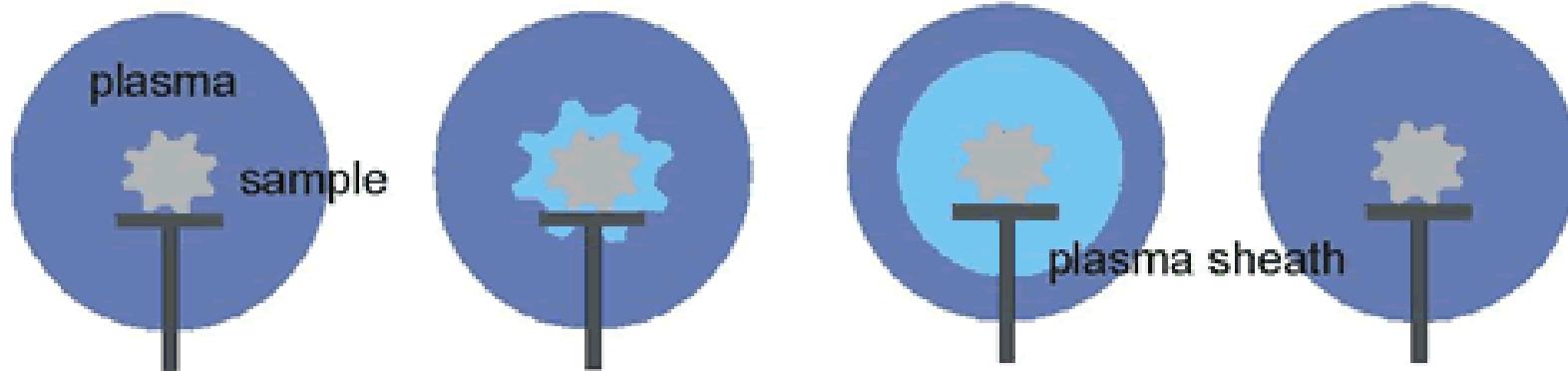




## Plasma Immersed Ion Implantation

The plasma immersion ion implantation process is of potentially great significance for the modification of surfaces, since in principle it permits the implantation of ions into a surface without the usual line-of-sight restrictions of ion-beam techniques.

# Plazmová implantácia



$$t = 0, U = 0$$

sample immersed  
in plasma

$$t = t_1, U = U_o$$

voltage pulse  $U_o$  from  $t_1$  to  $t_2$   
displacement of electrons ( $\sim 1$  ns)  
acceleration of ions ( $\sim 100$  ns)  
plasma sheath expansion ( $\sim 10 \mu\text{s}$ )

$$t_1 < t < t_2, U = U_o$$

$$t > t_2, U = 0$$

Plasma  
regeneration

# Plazmová implantácia

MUNI  
SCI

**A large vacuum chamber (1m diameter & 2m length) with plasma produced by the impact ionization of neutrals by thermionic electrons.**

**A magnetic cusp to enhance plasma density.**

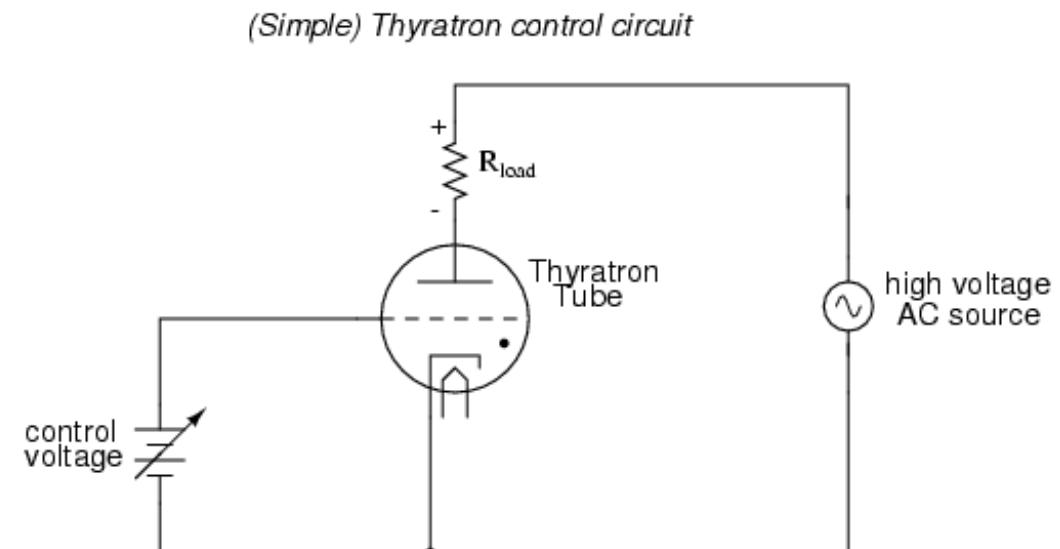
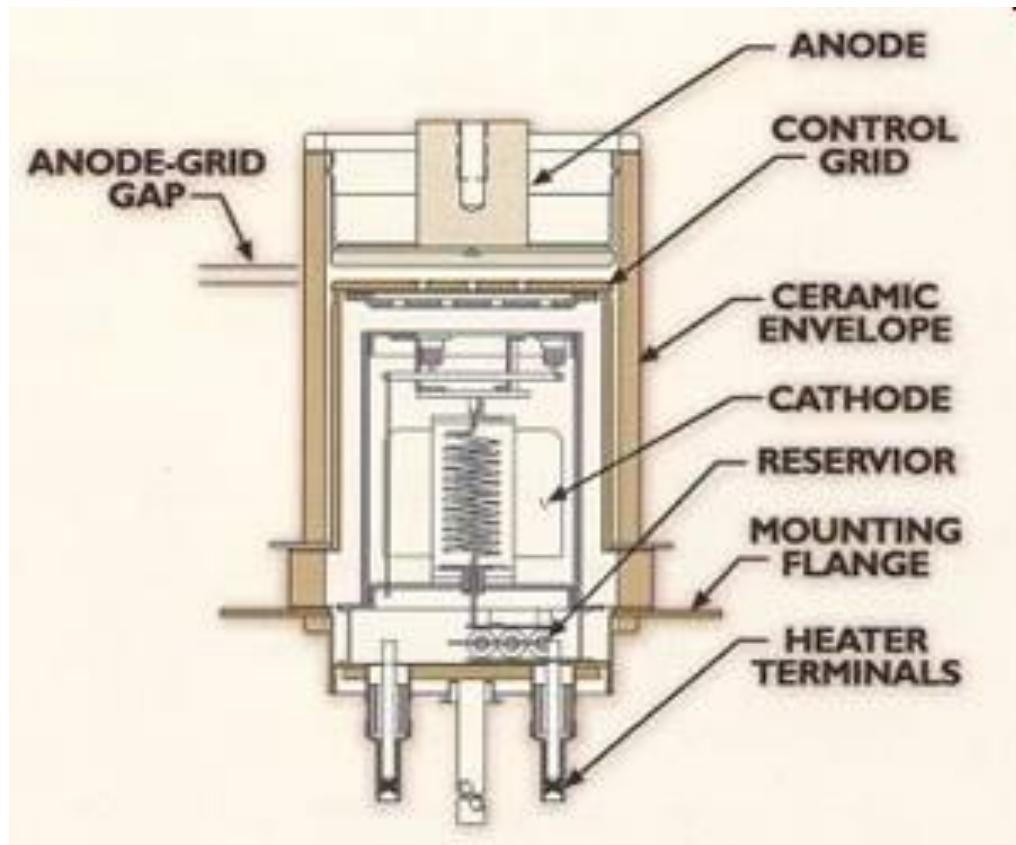
**A 50 kv DC supply with a hard tube modulator**



# Tyratrón

MUNI  
SCI

- spínacia plynom plnená elektrónka na báze t.v. na spínanie VN



Prúd tlecieho výboja s dutou katódou ako funkcia vzdialenosťi d medzi katódami (katódou a antikatódou) prúd prudko vzrástie keď sa **spoja obe záporné svetlá** (d je vzdialosť oboch katód)

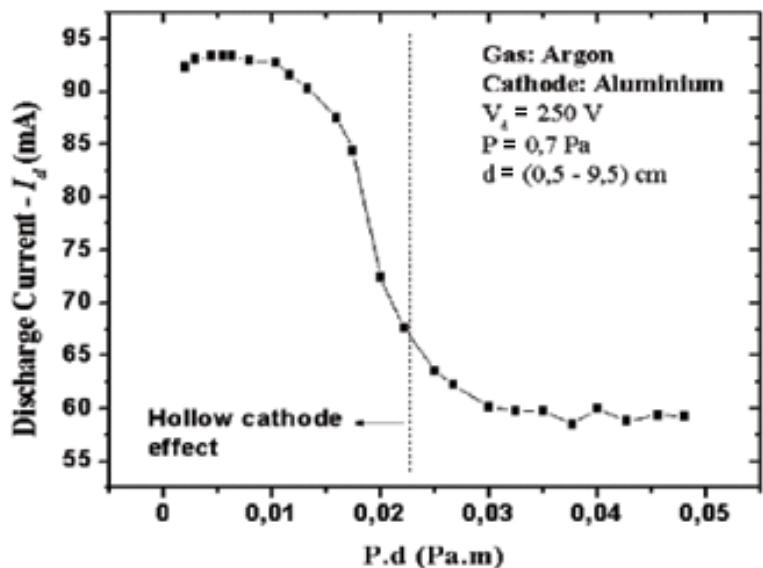
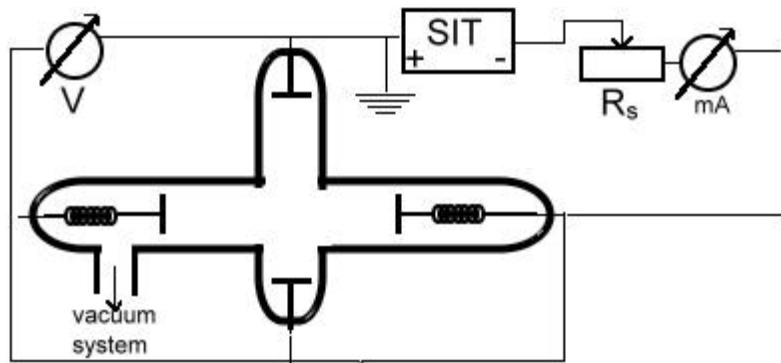
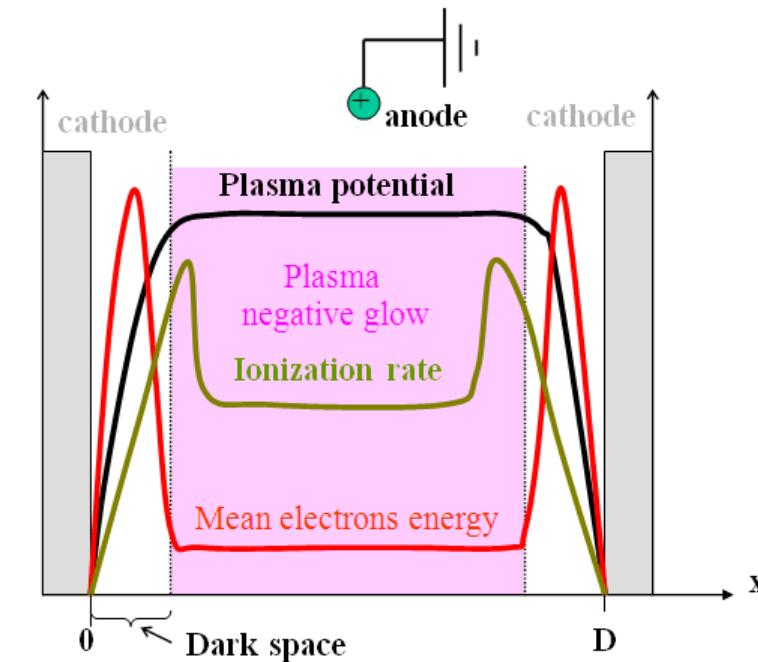
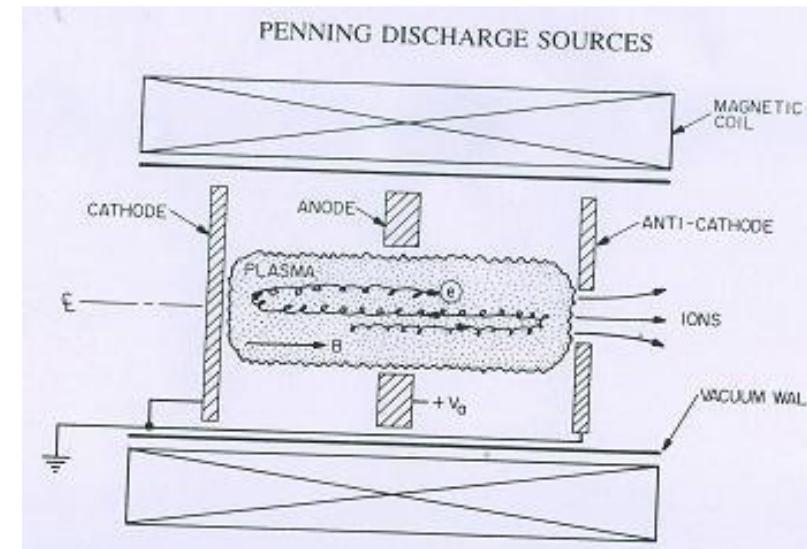
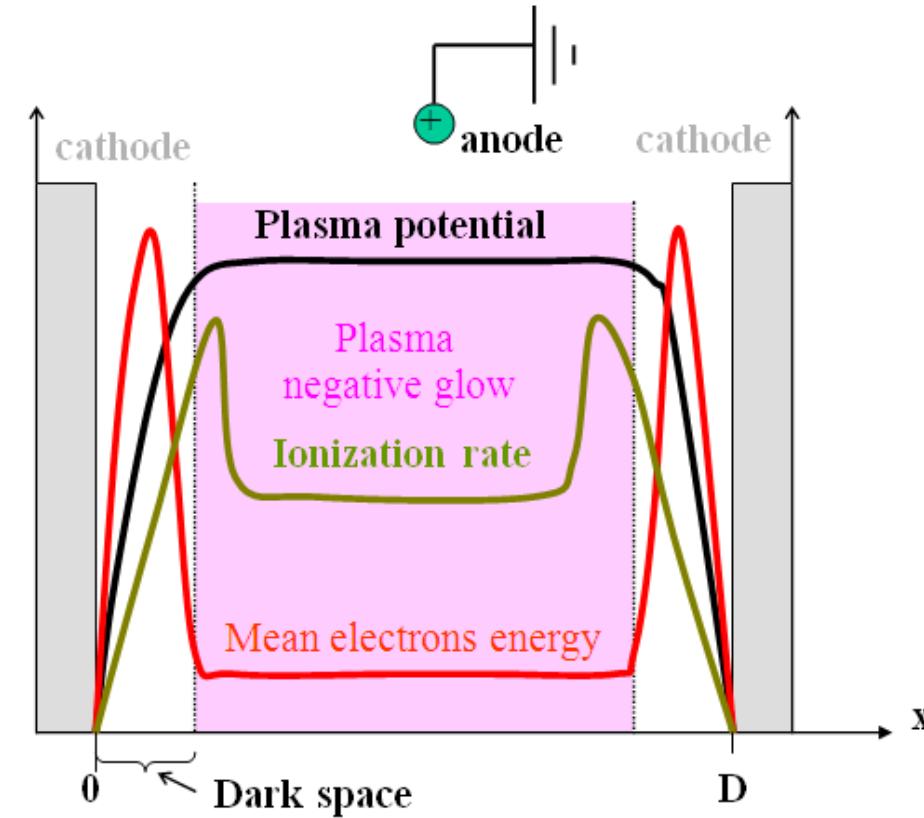
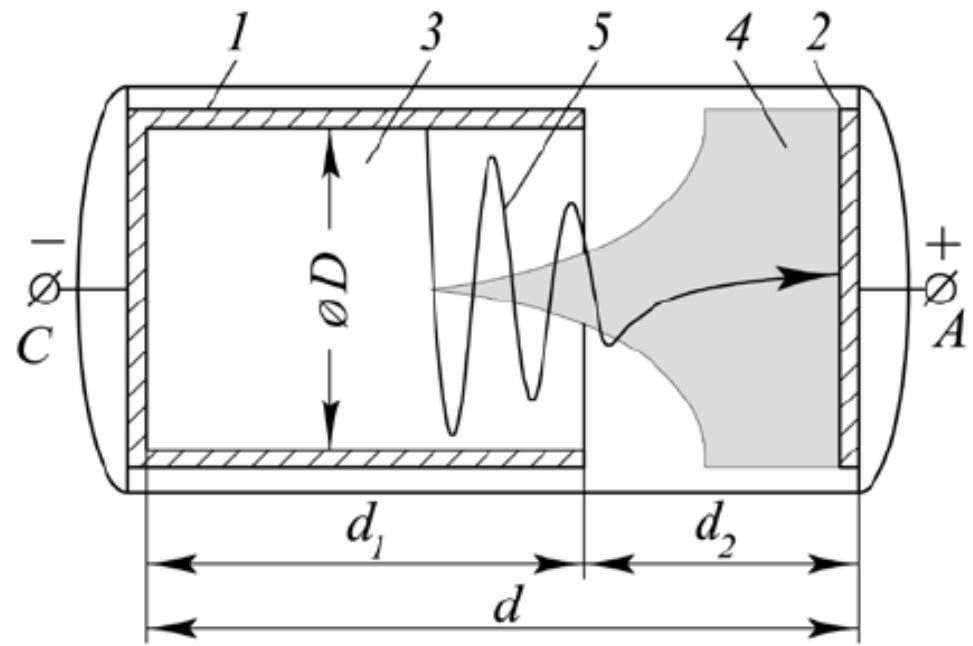


FIG. 2: Hollow Cathode discharge current as a function of the (P.d) parameter.

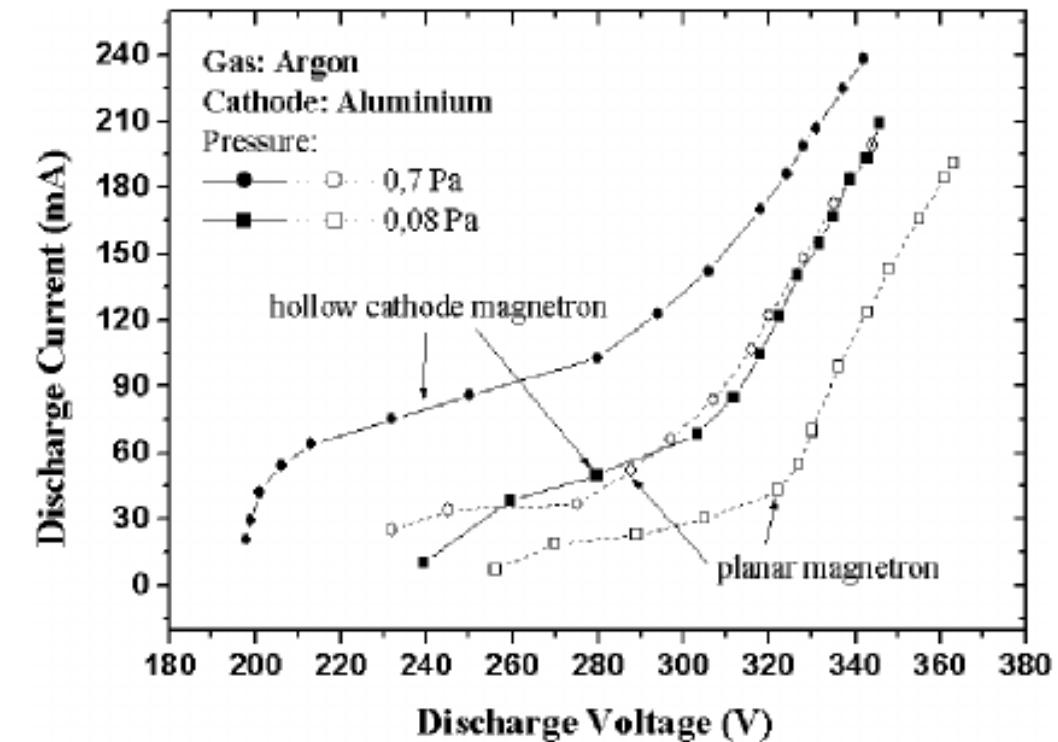
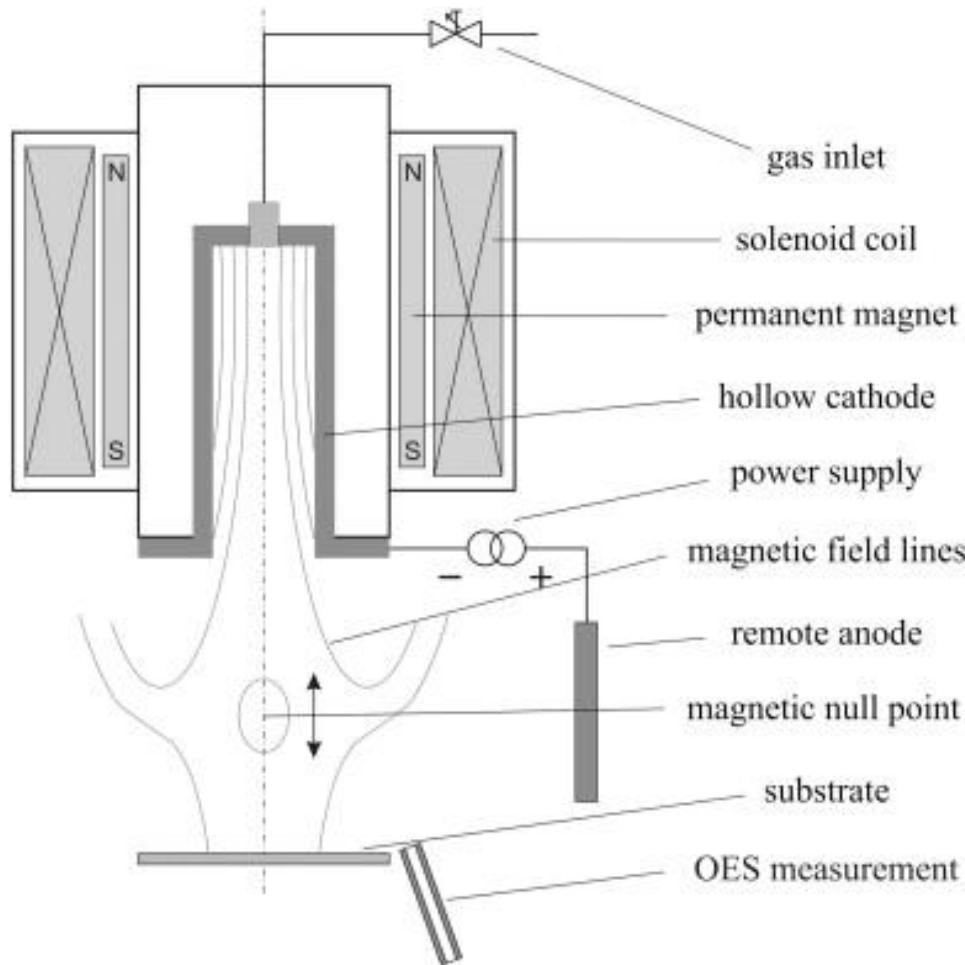


# Klasická konfigurácia tlecieho výboja s dutou katódou

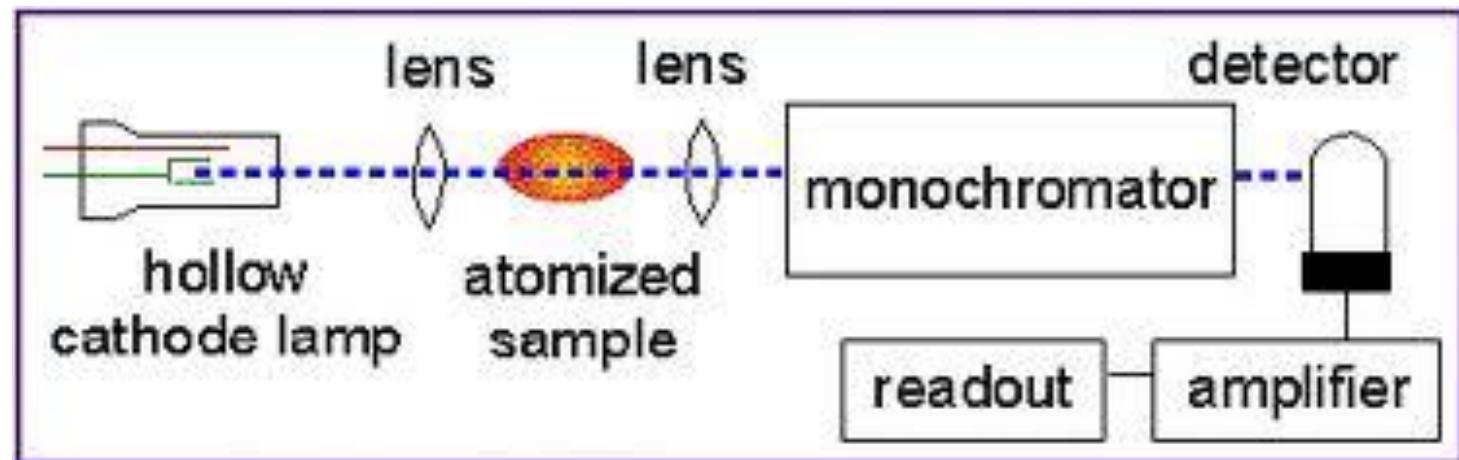
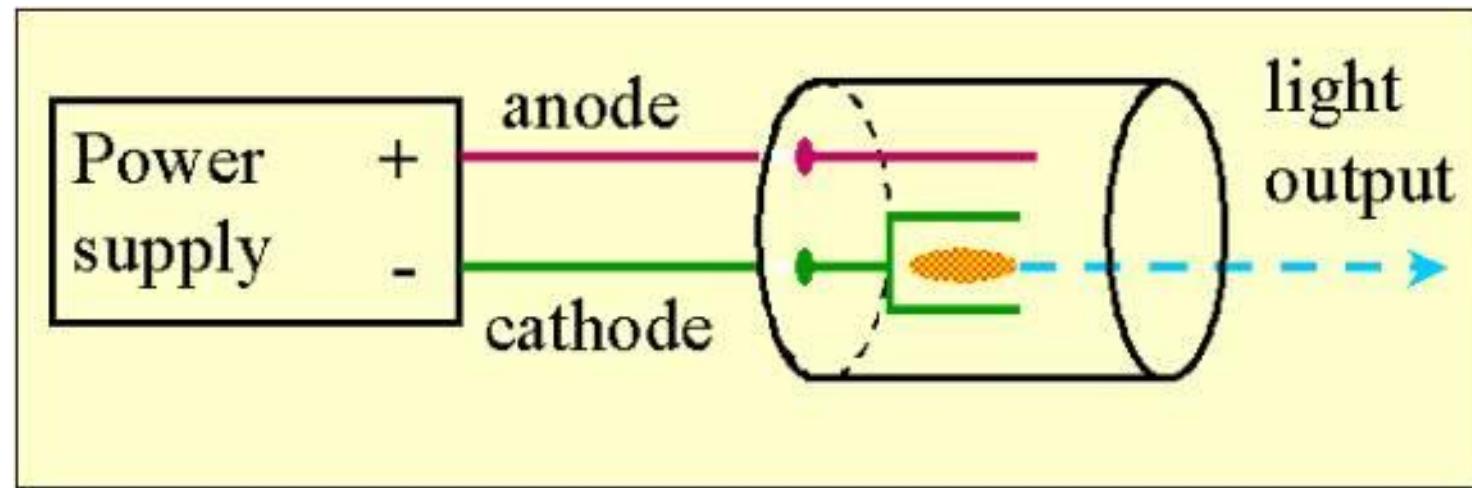


1 – hollow cathode, 2 – anode, 3 – positive space charge, 4 – plasma, 5 – electron trajectory

# Magnetrón s dutou katódou



## Tlecí výboj s dutou katódou ako zdroj žiarenia pre absorpcnú spektroskopiu:

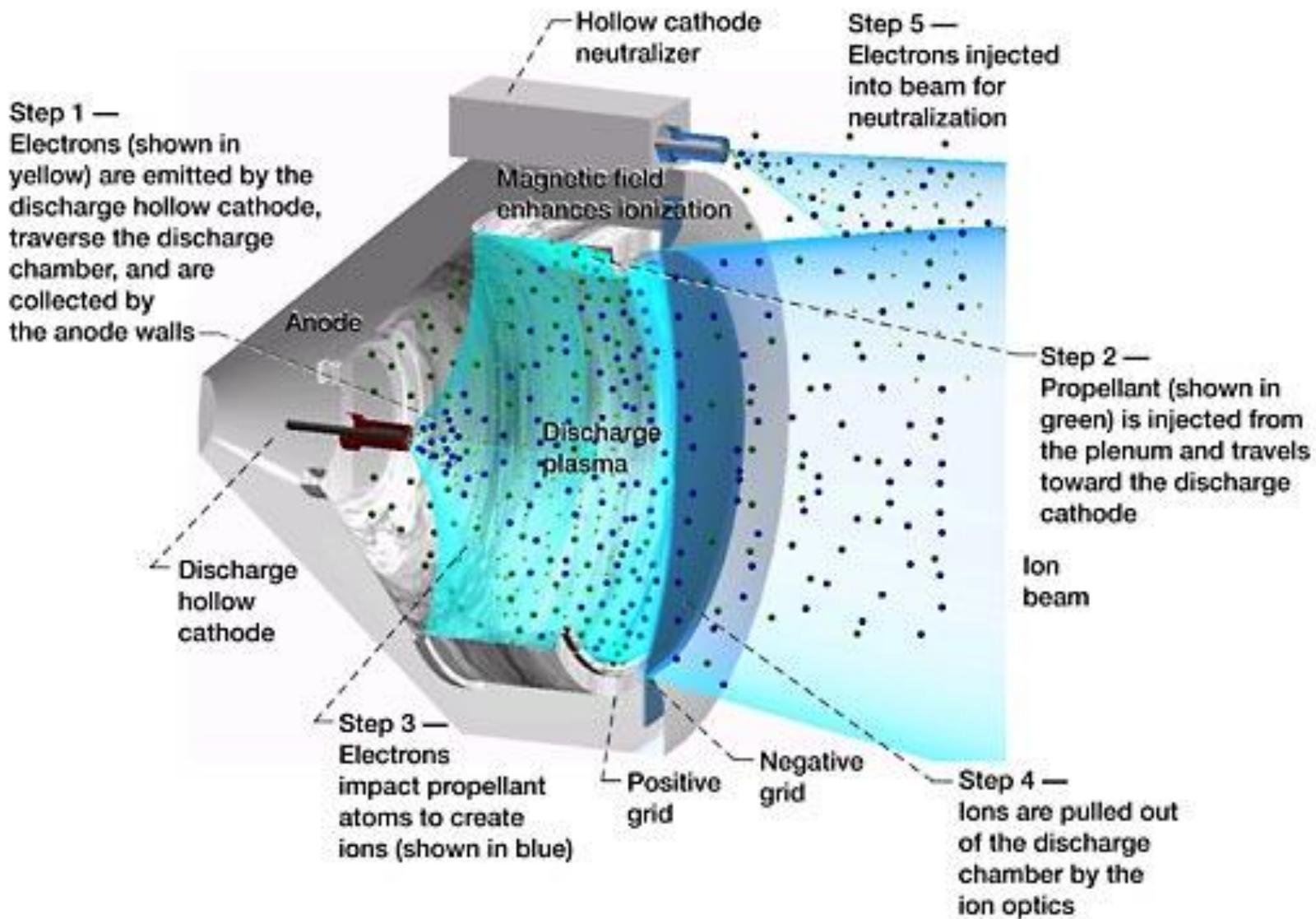


# Zdroje plazmy pre výrobu mikročipov

MUNI  
SCI



# Iónové reaktívne motory



# GLID ARC

**GLID ARC** – kízavý oblúkový výboj,  
v skutočnosti však **kízavý tlecí výboj**

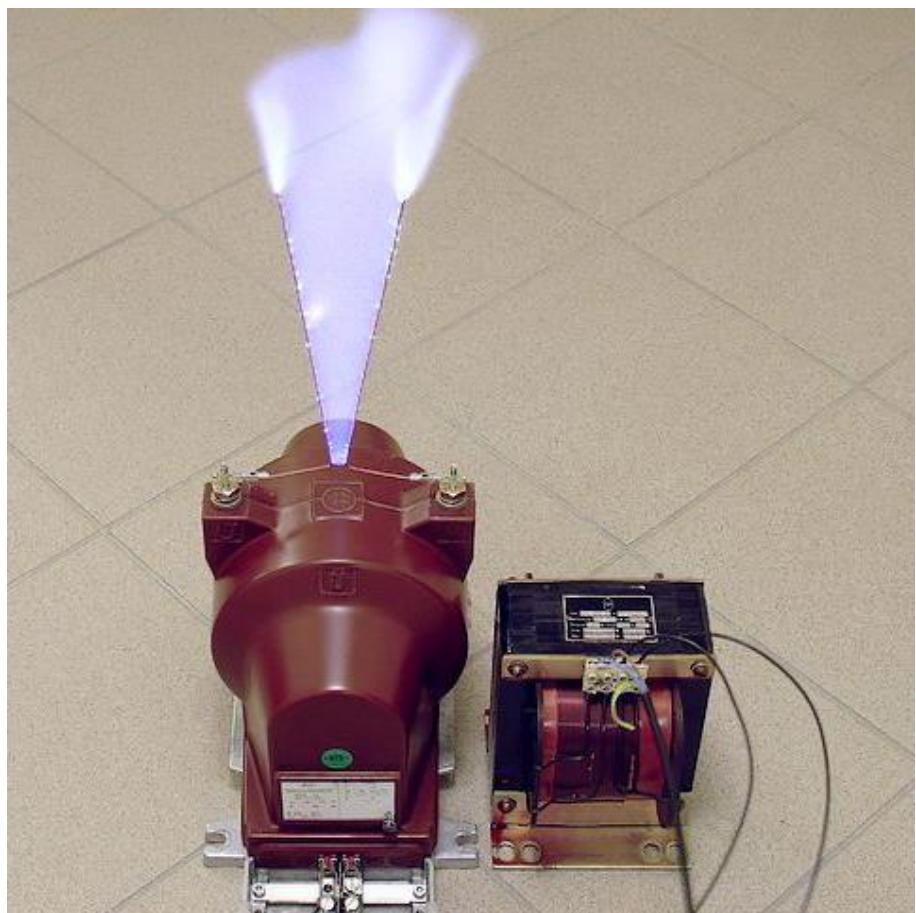


Figure 2.

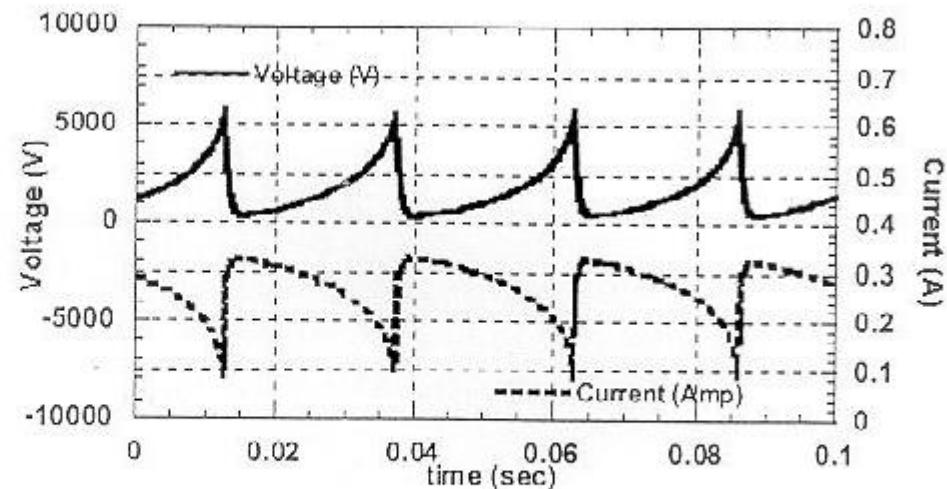
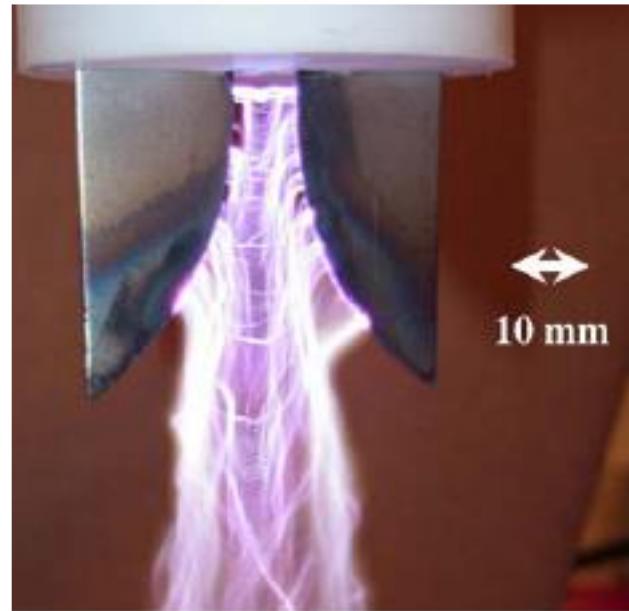
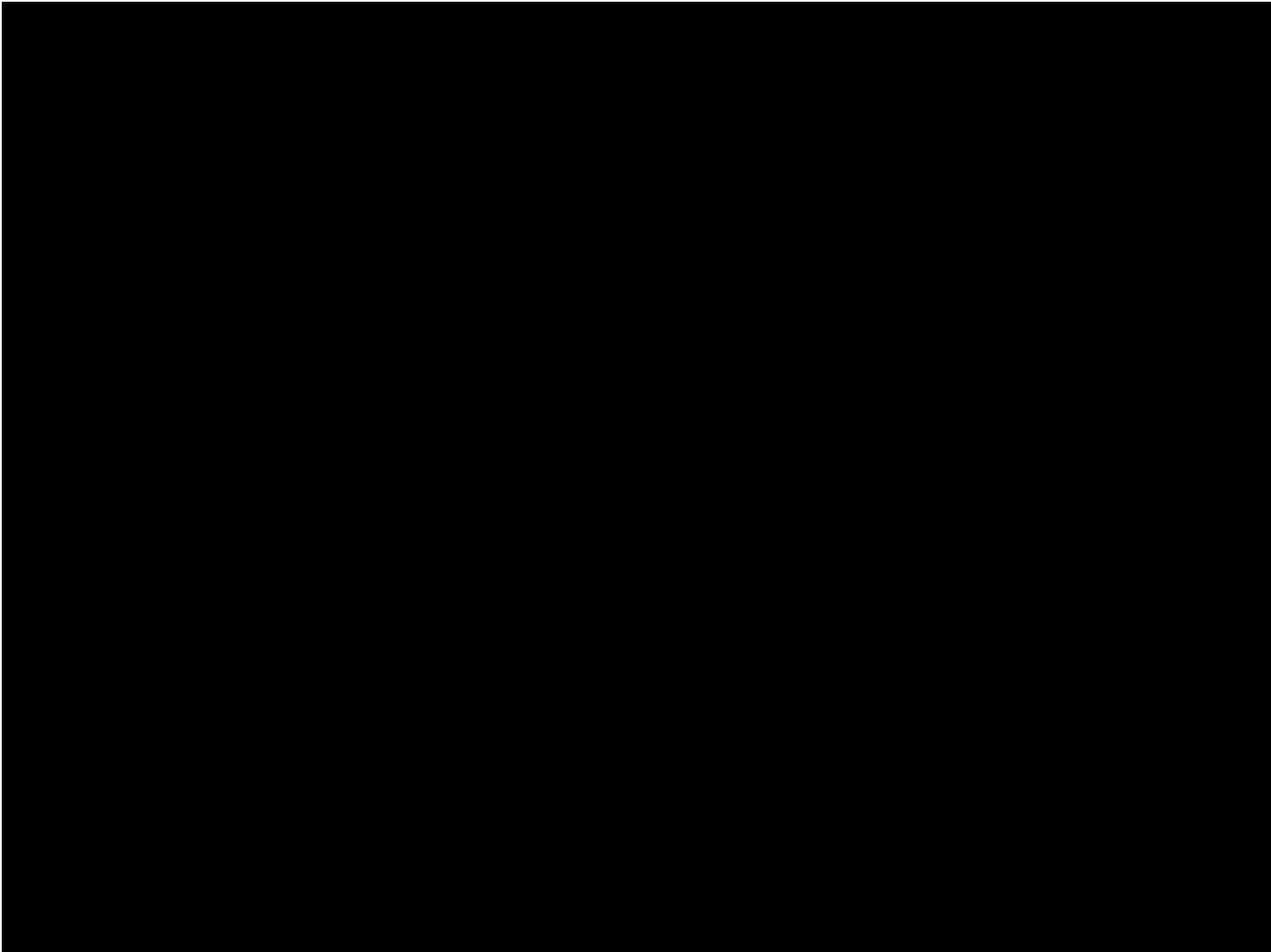


Figure 3. Current and voltage waveforms of the gliding arc discharge.



# GLID ARC

MUNI  
SCI



Glid\_Arc.mp4

# GLID ARC

MUNI  
SCI



Figure 2.

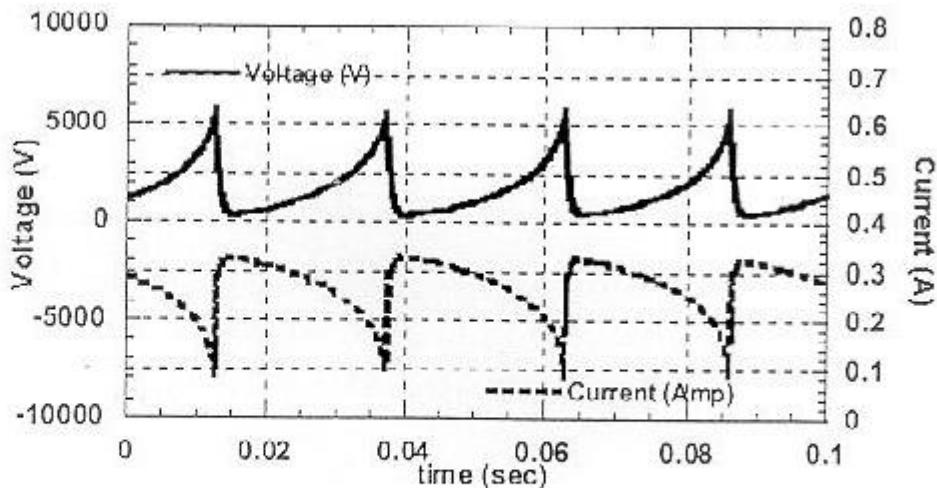


Figure 3. Current and voltage waveforms of the gliding arc discharge.

M A S A R Y K  
U N I V E R S I T Y